รหัสโครงการวิจัย SUT7-709-57-12-27



## รายงานการวิจัย

การใช้ X-ray จากแสงซินโครตรอนเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับสวิตซ์ลำแสง จากสายไฟเบอร์ออฟติก (Using X-ray from the Synchrotron Light Source for Development of Optical Fiber Switch)



ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

รหัสโครงการวิจัย SUT7-709-57-12-27



## รายงานการวิจัย

การใช้ X-ray จากแสงซินโครตรอนเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับสวิตซ์ลำแสง จากสายไฟเบอร์ออฟติก (Using X-ray from the Synchrotron Light Source for Development of Optical Fiber Switch)

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว พฤศจิกายน 2561

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2557-2558 และขอขอบคุณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องมือ ต่างๆ ในการทำวิจัย บัดนี้งานวิจัยได้สำเสร็จลุล่วงแล้ว คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ผู้วิจัย พฤศจิกายน 2561

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบ สร้าง และทดสอบอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงสำหรับประยุกต์ใช้งานกับ สายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียว โครงสร้างของอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงสร้างจากวัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นสารไวแสง ชนิดลบ SU-8 ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีจากระบบลำเลียงแสง 6a: DXL ของสถาบันวิจัย แสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) จากนั้นทำการเคลือบโหละโครเมียมและทองคำลงบนโครงสร้างเพื่อให้เกิด การนำไฟฟ้าและสามารถสะท้อนแสงได้ อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงของงานวิจัยนี้จะมีกระจกจุลภาคและตัวขับเร้า ทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี่เป็นส่วนประกอบหลักที่เคลื่อนที่ได้ 128 ซี่ เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า 190 V ส่วนที่ สามารถเคลื่อนที่ได้จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะ 100 μm โดยส่วนปลายของชุดซี่หวี่ที่เคลื่อนที่ได้จะมี กระจกจุลภาคขนาดความกว้าง 22.91 μm และหนา 356 μm ติดอยู่ เมื่อส่งสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่น 1310 nm การสูญเสียทางแสงเนื่องจากการสวิตซ์ที่น้อยที่สุดในขณะที่สวิตซ์เปิดและสวิตซ์ปิดมีค่าต่างกัน 16.20 dB



### Abstract

This research project presents the design, fabrication and measurement results of optical switch for single mode optical fiber. The optical switch is fabricated by using X-ray lithography technique in beamline 6a: DXL at the Synchrotron Light Research Institute (SLRI). All structures of the optical switch are fabricated by SU-8 photoresist coated with chromium and gold thin film for electrical conduction and optical reflection, respectively. A mirror which is attached to the end of moving part is used for reflect light from optical fiber. The mirror is 22.91  $\mu$ m wide and 356  $\mu$ m thick. A comb drive actuator in moving path has 128 fingers. It can travel 100  $\mu$ m for 190-V electric step signal. At a wavelength of 1310 nm, the difference of 16.20 dB was obtained between switch on and switch off state.



# สารบัญ

## หน้า

กิตติก	รรมประ	ะกาศ	. ก
บทคัด	ย่อ (ภา	าษาไทย)	. ข
บทคัด	ย่อ (ภา	าษาอังกฤษ)	. ค
สารบัย	ນູ		१
สารบัย	มูตารา <sub>`</sub>	9	. ລ
สารบัย	ญภาพ.		. V
คำอธิเ	มายสัญ	ลักษณ์และคำย่อ	.ຎູ
บทที่	1	บทนำ	. 1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	. 1
	1.2	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	. 2
	1.3	ข้อตกลงเบื้องต้น	. 2
	1.4	ขอบเขตการวิจัย	. 2
	1.5	วิธีดำเนินการวิจัย	. 2
		1.5.1 แนวทางการดำเนินงานวิจัย	. 2
		1.5.2 สถานที่ทำการวิจัย	. 2
		1.5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	. 3
	1.6	ประโยชน์ที่คาดว่าจ <mark>ะได้รับ</mark>	. 3
	1.7	ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย	. 3
บทที่	2	ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	. 4
	2.1	ระบบกลไฟฟ้าจุลภาค	. 4
	2.2	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	. 4
บทที่	3	กระบวนการพื้นฐานในการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาค	11
	3.1	กระบวนการลิโธกราฟฟี	11
	3.2	การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า	12
	3.3	การเคลือบโลหะด้วยการสปัตเตอริง	13
	3.4	การเตรียมสารไวแสง	14
	3.5	การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์	18
	3.6	การสร้างลวดลายบนแผ่นวงจรพิมพ์	21

# สารบัญ(ต่อ)

				หน้า		
บทที่	4	ทฤษฎีที	ี่เกี่ยวข้องและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	24		
	4.1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง				
		4.1.1	โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสง	25		
		4.1.2	ชนิดของสายใยแก้วนำแสง	26		
		4.1.3	หัวเชื่อมต่อ (Connector)	32		
	4.2	ทฤษฎีที่	ง้นฐานเกี่ยวกับตัวขับเร้าทางไฟฟ้ <mark>าส</mark> ถิตและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	33		
		4.2.1	ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่ห <mark>ว</mark> ี	34		
			(Electrostatic comb-drive actuator)			
		4.2.2	ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบ <mark>แ</mark> ผ่นคู่ขนาน	43		
			(Electrostatic parallel plate actuator)			
	4.3	การออก	าแบบโครงสร้างอุปกรณ์สว <mark>ิตช์</mark> เชิงแสง	48		
บทที่	5	กระบวเ	นการพัฒนาอุปกรณ์สวิต <mark>ช์เชิง</mark> แสง	52		
	5.1	การสร้า	เงอุปกรณ์สวิตช์เชิงแ <mark>สง</mark>	52		
	5.2	รูปแบบ	ของอุปกรณ์สวิตช์ <mark>เชิ</mark> งแสงที่มีการสร้างขึ้นในงานว <b>ิจ</b> ัย	61		
บทที่	6	การทดส	สอบและผลการทุดสอบ	66		
	6.1	การเชื่อ	มสายอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	66		
		6.1.1	เชื่อมต่อตัว <mark>ขับเร้า</mark> ทางไฟฟ้าสถิตกับแหล่งจ่ายแร <mark>งดันสูง</mark>	66		
		6.1.2	เชื่อมต่อสายใ <mark>ยแก้วนำแสงกับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง</mark>	67		
	6.2	การทดส	สอบการเคลื่อนที่	68		
	6.3	การทดส	สอบการสวิตช์แสง	72		
	6.4	แนวทาง	งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	75		
บทที่	7	สรุปงาเ	เวิจัยและข้อเสนอแนะ	76		
	7.1	สรุปงาเ	มวิจัย	77		
	7.2	ข้อเสนอ	ງແນະ	77		
ภาคผ	นวก	โปรแกร	มแบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์	78		
รายกา	ารอ้างอิ	۹		85		
ประวัต	ติผู้วิจัย			87		

# สารบัญตาราง

	ห	น้า
ตารางที่ 2.1	เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Raanan กับ DiCon	. 5
ตารางที่ 2.2	ผลการจำลองค่าการสะท้อนแสงของโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่น 1310 nm	. 6
ตารางที่ 2 3	ค่าคมลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สาิตซ์เซิงแสงของ Cornel Marver	6

หน้า

ตารางที่ 2.2	ผลการจำลองค่าการสะท้อนแสงของโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่น 1310 nm 6
ตารางที่ 2.3	ค่าคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Cornel Marxer
ตารางที่ 2.4	ค่าคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Ho Nam Khon
ตารางที่ 4.1	โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว
ตารางที่ 4.2	คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว
ตารางที่ 4.3	โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงชนิดหล <mark>ายโ</mark> หมดแบบ Step index
ตารางที่ 4.4	คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วนำแ <mark>สงชนิดห</mark> ลายโหมดแบบ Step index
ตารางที่ 4.5	โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index
ตารางที่ 4.6	คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index
ตารางที่ 4.7	คุณสมบัติของหัวเชื่อมต่อชนิดต่าง ๆ
ตารางที่ 4.8	สัญลักษณ์ของอุปกรณ์สวิตช์เชิง <mark>แ</mark> สง
ตารางที่ 5.1	ขนาดพารามิเตอร์ของอุปกร <mark>ณ์สวิ</mark> ตช์เช <mark>ิงแสงที่ออกแบบ (</mark> ตามตารางที่ 4.8)
	และได้จากการสร้างจริง
ตารางที่ 6.1	ค่าการรับส่งแสงผ่านตั <mark>ว</mark> กลางที่เป็นอากาศ หน่วย dBm
ตารางที่ 6.2	้ค่าการสูญเสียของแ <mark>สงเนื่องจากการส่งแสงผ่านตัวกลาง</mark> ที่เป็นอากาศเทียบกับ
	การส่งผ่านสายใยแก้ <mark>วนำแสงโ</mark> ดยตรง หน่วย dB
ตารางที่ 6.3	้ค่าการรับส่งแสงผ่านการ <mark>สะท้อนจากกระจกจุลภาค หน่วย</mark> dBm75
ตารางที่ 6.4	ค่าการสูญเสียของแสงเนื่องจากการสะท้อนของกระจกจุลภาคเทียบกับ
	การส่งผ่านอากาศ หน่วย dB

# สารบัญภาพ

		หน้า
รูปที่ 2.1	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Koji Akimoto	5
รูปที่ 2.2	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Raanan A. Miller	6
รูปที่ 2.3	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Cornel Marxer	7
รูปที่ 2.4	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Hiroshi Toshiyoshi	7
รูปที่ 2.5	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Shi-Sheng Lee	8
รูปที่ 2.6	อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงของ Ho Nam Kh <mark>on</mark>	9
รูปที่ 2.7	อุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงของ Chang-Hyeo <mark>n</mark> Ji	10
รูปที่ 3.1	เปรียบเทียบการใช้สารไวแสงสองชนิด <mark>ในกระบ</mark> วนการลิโธกราฟฟี	12
รูปที่ 3.2	การชุบโลหะเงินด้วยไฟฟ้า	13
รูปที่ 3.3	เครื่องเคลือบโลหะแบบสปัตเตอริง	14
รูปที่ 3.4	การเตรียมสารไวแสงด้วยการหมุ <mark>นเคล</mark> ือบ	15
รูปที่ 3.5	การเตรียมสารไวแสงด้วยการหย <mark>ุด</mark> 7	16
รูปที่ 3.6	กระบวนการหล่อสารไวแสง <mark>จาก</mark> ผงแห้งและอุปกรณ์	17
รูปที่ 3.7	ชั้นของสารไวแสงหลังจากการเตรียมสารไวแสง	17
รูปที่ 3.8	ขั้นตอนการสร้างหน้า <mark>กา</mark> กกั้นรังสีเอกซ์	18
รูปที่ 3.9	ฐานรองสำหรับสร้า <mark>งหน้</mark> ากา <mark>กกั้นรังสีเอกซ์</mark>	19
รูปที่ 3.10	ลวดลายหลังฉายแส <mark>งของหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์สำหรับอุปกรณ์ส</mark> วิตช์เชิงแสง	20
รูปที่ 3.11	หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์สำหรับอ <mark>ุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง</mark>	21
รูปที่ 3.12	แผ่นวงจรพิมพ์	21
รูปที่ 3.13	ติดแผ่นฟิล์มไวแสงบนแผ่นวงจรพิมพ์	22
รูปที่ 3.14	ฉายแสงอัลตราไวโอเลตบนฟิล์มไวแสง	22
รูปที่ 3.15	ฐานรองอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	23
รูปที่ 4.1	สายใยแก้วนำแสง	25
รูปที่ 4.2	ส่วนประกอบของสายใยแก้วนำแสง	26
รูปที่ 4.3	ขนาดของสายใยแก้วนำแสง	26
รูปที่ 4.4	โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว	27
รูปที่ 4.5	โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Step index	29
รูปที่ 4.6	สเปคตรัมการลดทอนสัญญาณของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ	30
	Step index	

# สารบัญภาพ(ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 4.7	โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index	31
รูปที่ 4.8	ลักษณะของแผ่นตัวนำคู่ขนาน	34
รูปที่ 4.9	โครงสร้างของตัวขับเร้าแบบซี่หวี	35
รูปที่ 4.10	โมเดลของตัวขับเร้าแบบซี่หวี	35
รูปที่ 4.11	ลักษณะแรงที่เกิดบนคานสปริงแบบ fixed-fixed beam	36
รูปที่ 4.12	คานสปริงแบบ fixed-fixed beams	37
รูปที่ 4.13	คานสปริงแบบ folded beam	37
รูปที่ 4.14	คานสปริงแบบ serpentine beam	38
รูปที่ 4.15	แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้องป้อนให้ตั <mark>ว</mark> ขับเร <mark>้าเ</mark> มื่อเทียบกับจำนวนซี่หวี	40
รูปที่ 4.16	แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้องป้อนให้ตัวขับเร้าเมื่อเทียบกับ	41
	ระยะห่างระหว่างซี่หวีทั้งสองขั้ว 🥖 📥 🖕	
รูปที่ 4.17	แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้องป้อ <mark>นให้</mark> ตัวขับเร้าเมื่อเ <mark>ทียบ</mark> กับความสูงของซี่หวี	42
รูปที่ 4.18	แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้อ <mark>งป้อ</mark> นให้ตัวขับเร้าเมื่อเที <mark>ยบก</mark> ับระยะที่ซี่หวีเคลื่อนที่	43
รูปที่ 4.19	ลักษณะโครงสร้างของตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนาน	44
รูปที่ 4.20	โมเดลของตัวขับเร้าแ <mark>บบ</mark> แผ่นคู่ขนาน	44
รูปที่ 4.21	แรงดันไฟฟ้าแนบติ <mark>ดที่เกิ</mark> ดขึ้นในตัวขับเร้าเมื่อเทียบกับจำนวนแผ่นตัวนำ	47
รูปที่ 4.22	โครงสร้างด้านบนของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	48
รูปที่ 4.23	โครงสร้างสามมิติของอุป <mark>กรณ์สวิตช์เชิงแสง</mark>	48
รูปที่ 4.24	ขนาดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	50
รูปที่ 5.1	ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	53
รูปที่ 5.2	สารไวแสงบนฐานรองกราไฟต์สำหรับสร้างโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง	54
รูปที่ 5.3	ฉายรังสีเอกซ์	55
รูปที่ 5.4	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์	55
รูปที่ 5.4	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์	56
รูปที่ 5.6	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสง	56
รูปที่ 5.7	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงก่อนและหลังขัดกราไฟต์	57
รูปที่ 5.8	เชื่อมต่อโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแผ่นวงจรพิมพ์	58
รูปที่ 5.9	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ติดอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์	59
รูปที่ 5.10	ขนาดโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สร้างได้จริง	60

# สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 5.11	เปรียบเทียบผลการจำลองการตอบสนองของตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต
	ที่ออกแบบกับที่สร้างได้จริง
รูปที่ 5.12	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี
	มีคานสปริงแบบ fixed-fixed beam
รูปที่ 5.13	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี
	และมีคานสปริงแบบ serpentine 8 ขด <mark>วา</mark> งตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค
รูปที่ 5.14	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับ <mark>เร</mark> ้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี
	และมีคานสปริงแบบ serpentine 12 <mark>ขด</mark> วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค
รูปที่ 5.15	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัว <mark>ขับเร้าทา</mark> งไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน
	และมีคานสปริงแบบ serpentine 1 <mark>2</mark> ขด วา <mark>ง</mark> ตัวขนานกับกระจกจุลภาค
รูปที่ 5.16	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ <mark>มีตัว</mark> ขับเร้าทา <mark>งไฟ</mark> ฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน
	ละมีคานสปริงแบบ serpentine 12 ขด
รูปที่ 5.17	โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิง <mark>แสง</mark> ที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้ <mark>าสถิ</mark> ตแบบซี่หวี
	ละมีคานสปริงแบบ serpentine 12 ขด วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค
รูปที่ 6.1	เชื่อมต่อสายทองแดงกับขั้วตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต
รูปที่ 6.2	เชื่อมสายของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแหล่งจ่ายแรงดันสูง
รูปที่ 6.3	เชื่อมต่อสายใยแก้วน <mark>ำแสง</mark> กับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง
รูปที่ 6.4	ผลการจำลองการตอบส <mark>นองของโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิง</mark> แสงที่สร้างได้จริง
รูปที่ 6.5	ชุดขับอุปกรณ์สวิตช์เซิงแสงในงานวิจัย
รูปที่ 6.6	ทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี71
รูปที่ 6.7	วัดค่ากำลังของแสงที่ส่งออกมาจากแหล่งจ่ายสัญญาณแสง
รูปที่ 6.8	เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแหล่งจ่ายสัญญาณแสง73
รูปที่ 6.9	ทดสอบการรับส่งแสงผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอากาศ73
รูปที่ 6.10	ทดสอบการรับส่งแสงโดยการสะท้อนจากกระจกจุลภาค
รูปที่ 6.11	พื้นผิวบริเวณผนังด้านข้างของกระจกจุลภาค76
รูปที่ 6.12	โครงสร้างกระจกจุลภาคที่เหมาะสม77

# คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

$F_{e}$	คือ แรงไฟฟ้าสถิต มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
$Q_1$ , $Q_2$	คือ ประจุไฟฟ้าแบบจุด มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ (C)
R	คือ ระยะทางระหว่างประจุ $oldsymbol{Q}_1$ และ $oldsymbol{Q}_2$
$\boldsymbol{\mathcal{E}}_0$	คือ ค่า permittivity ของสุญญากาศ มีค่าเท่ากับ 8.85 × 10 <sup>-12</sup> F/m
$\mathcal{E}_r$	คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง
Ν	คือ จำนวนซี่ของตัวขับเร้า
V	คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อน
g	คือ ขนาดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้ <mark>า</mark> ทั้งสองขั้ว
$F_{s}$	คือ แรงปฏิกิริยาหรือแรงดึงกลับข <mark>อง</mark> สปริง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
x	คือ ระยะของการเคลื่อนที่
E	คือ ค่าความยืดหยุ่นของวัสดุ ( <mark>Y</mark> oung <mark>'s</mark> modulus)
W	คือ ความกว้างของสปริง 🗾 💿 🚺
t	คือ ความสูงของสปริง
l	คือ ความยาวของสปริง
k	คือ ค่าคงที่สปริง ห <mark>น่วยเ</mark> ป็น นิวตันต่อเมตร (N/m)
G	คือ ค่ามอดูลัสของการบิด (Torsion modulus)
J	คือ ค่าคงที่ของการบิด (Torsion constant) 📔 🤍
$l_a$	คือ ความกว้างของสปริง
$l_b$	คือ ความยาวของสปริง
Ε	คือ ค่าความยืดหยุ่นขอ <mark>งวัสดุ</mark> (Young's modulus)
$I_x$	คือ โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of inertia) ของสปริง
n	คือ จำนวนขดของสปริง สียเทคโนโลยสร้
9	คือ ค่าอัตราส่วนของปัวซอง (Poisson's ratio)
$I_x$	คือ โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of inertia) ของสปริง
g	คือ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว
$k_x$	คือ ค่าคงที่สปริงที่จำนวนขดของสปริงเพิ่มขึ้นในแนวแกน x
t	คือ ความสูงของขั้วไฟฟ้า
$V_{pi}$	คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าแนบติด มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
A	คือ พื้นที่ผิวบริเวณที่เกิดประจุไฟฟ้า

บทที่ 1 บทนำ

เนื้อหาในบทนี้เป็นการอธิบายถึงความเป็นมาและเหตุจูงใจสำหรับการทำวิจัยเรื่อง การใช้ X-ray จากแสงซินโครตรอนเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับสวิตซ์ลำแสงจากสายไฟเบอร์ออฟติก โดยนำเทคนิค ซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แนวทางการดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของรายงานการวิจัย

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการสื่อสารทางแสงโดยผ่านใยแก้วนำแสงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก อันเนื่องมาจาก สามารถส่งข้อมูลไปได้ในระยะที่ไกลมากโดยใช้ตัวทวนสัญญาณน้อยเพราะมีการสูญเสียสัญญาณต่ำ กว่าสัญญาณไฟฟ้า อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูง ที่สำคัญการลักลอบขโมยสัญญาณจาก ระบบใยแก้วนำแสงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงทำให้ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่โดยปกติแล้วการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงจะเป็นแบบจุดต่อจุด (point to point) หากต้องการ สื่อสารแบบหนึ่งจุดต่อหลายจุด (point to multipoint) จะต้องใช้สายใยแก้วนำแสงหลายเส้น ด้วย เหตุนี้จึงมีการสร้างอุปกรณ์ที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวสวิตช์แสงเพื่อลดจำนวนการใช้สายใยแก้วนำแสง ให้น้อยลง

ระบบกลไฟฟ้าจุลภาค หรือ Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) เป็นอุปกรณ์ที่มี ขนาดเล็กระดับไมโครเมตร หรือ 1 ในล้านของเมตร ประกอบด้วยส่วนที่ใช้ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อน และส่วนที่ใช้กลไกบางอย่างทำให้เคลื่อนที่ อาจสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit Technology : IC) เทคนิคการปลูกสาร เทคนิคการกัดกำจัด และเทคนิคการ สร้างรูปแบบด้วยกระบวนการโฟโตลิโธกราฟฟี ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เติบโต อย่างสูงและต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้รับความสนใจและก้าวล้ำไปอย่างมากทั่วโลก อันเนื่องมาจากความ ต้องการอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สมรรถนะสูง และราคาถูก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น เทคโนโลยียานยนต์นำไปผลิตอุปกรณ์วัดความเร่งและ อุปกรณ์วัดความดัน เทคโนโลยีการแพทย์และชีวภาพนำไปผลิตตัวตรวจรู้ (Sensors) และตัวขับเร้า (Actuators) ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนำไปผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทาง แสง ดังนั้นจึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงโดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี สำหรับใช้เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางแสงขึ้น

กระจกแนวตั้งที่วางในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวของชิพกำลังเป็นที่น่าสนใจในระบบเชิงแสงจุลภาค การติดตั้งใยแก้วนำแสงและเลเซอร์ไดโอดให้อยู่ในแนวขนานกับระนาบของตัวชิพเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย นอกจากนี้การสร้างกระจกที่วางตัวในแนวตั้งให้มีคุณภาพเชิงแสงที่สูงนั้นยังคงเป็นงานที่ท้าทาย เทคนิคการสร้างมากมายได้ถูกวิจัยขึ้น

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนากระบวนการสร้าง การผลิตอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบไฟฟ้า สถิต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนสูง โดยใช้รังสีเอกซ์ เพื่อให้สามารถนำไป ประยุกต์และใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงของงานวิจัยนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ กระจกจุลภาคทำหน้าที่ เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางของแสง และส่วนที่สองคือตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระจก จุลภาคให้สามารถเคลื่อนที่ได้

### 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 นำเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์สวิตช์ เชิงแสง

1.2.2 พัฒนาเทคนิคการเคลือบทองค<mark>ำ</mark>ลงบน<mark>ก</mark>ระจกจุลภาคเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสง

1.2.3 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเชิงแสง เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต

### 1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น

โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงสร้างจากพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) เคลือบ โลหะ

#### 1.4 ขอบเขตการวิจัย

สร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแ<mark>สงโดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟี</mark>

#### 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

#### 1.5.1 แนวทางการดำเนินงานวิจัย

- 1) สำรวจปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- 2) ศึกษากระบวนการผลิตโครงสร้างระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
- 3) ออกแบบอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบไฟฟ้าสถิต
- 4) สร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบไฟฟ้าสถิต
- 5) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างและการผลิตอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ

าคโนโลยีสุรบ

ไฟฟ้าสถิต

 6) ทดสอบการทำงาน วิเคราะห์ สรุปผลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสร้างและ ทดสอบการทำงาน

#### 1.5.2 สถานที่ทำการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ Beam Line 6a : DXL สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

#### 1.5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- 1) โปรแกรมออกแบบลวดลาย Layout Editor
- 2) โปรแกรมแมทแลบ (MATLAB)
- 3) ห้องสะอาด (Clean room) และอุปกรณ์
- 4) เครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
- 5) รังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแ<mark>สง</mark>ซินโครตรอน
- 6) เครื่องเคลือบโลหะแบบการสปัตเตอริง

### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สร้า<mark>งจา</mark>กเทคนิค<mark>ซินโ</mark>ครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี
- 1.6.2 พัฒนาเทคนิคการเคลือบทองคำลงบนกระจกจุลภาคเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสง
- 1.6.3 พัฒนาองค์ความรู้ใหม<mark>ในก</mark>ระบว<mark>นการผลิตระบบก</mark>ลไฟฟ้าจุลภาค

### 1.7 ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วย 7 บท ดังนี้

บทที่ 1 เป็นบทน<mark>ำ กล่า</mark>วถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย ข้อตกล<mark>งเบื้องต้น ขอบเขตงานวิจัย วิธีดำเนินง</mark>านวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ

บทที่ 2 กล่าวถึงการปริทัศน์วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง แบบไฟฟ้าสถิตในระบบกลไฟฟ้า

บทที่ 3 กล่าวถึงกระบวนการทางระบบกลไฟฟ้าจุลภาค ที่เกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิง แสง ได้แก่ กระบวนการลิโธกราฟฟี กระบวนการเคลือบโลหะ กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กระบวนการเตรียมสารไวแสง การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ และการสร้างลวดลายบน แผ่นวงจรพิมพ์

บทที่ 4 กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของสายใยแก้วนำแสง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำลอง พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อน (Driving voltage) และการคำนวณแรงดันไฟฟ้าแนบติด (Pull-in voltage)

บทที่ 5 กล่าวถึงการสร้างและพัฒนากระบวนการผลิตอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

บทที่ 6 กล่าวถึงการทดสอบและผลการทดสอบ บทที่ 7 กล่าวถึงการสรุปผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ได้แก่ ภาคผนวก ก. โปรแกรมแบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์ของแรงดันทางไฟฟ้าขับเคลื่อนและ แรงดันไฟฟ้าแนบติด



## บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ระบบกลไฟฟ้าจุลภาค

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากใน ปัจจุบัน เป็นศาสตร์ที่รวบรวมเอาความรู้และวิชาการหลากหลายสาขาทั้งด้านไฟฟ้า เครื่องกล วัสดุ ศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ รวมทั้งด้านระบบการวัดและระบบควบคุม ผนวกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างหรือผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กในระดับไมโครเมตรถึงมิลลิเมตรที่มีความสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในด้านอุตสาหกรรม ยานยนต์ การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ระบบการสื่อสาร ดังตัวอย่างเช่น ตัวตรวจรู้ความชื้น ตัวตรวจรู้ความดัน ตัวตรวจรู้ความเร่งสำหรับถุงลมนิรภัยและระบบความปลอดภัย อุปกรณ์วัดความ โน้มเอียงสำหรับเครื่องบิน เป็นต้น อุปกรณ์ที่ได้กล่าวมาส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและ สำคัญต่อชีวิตประจำวันทั้งสิ้น

การสร้างหรือผลิตอุปกรณ์ทางระบบกลไฟฟ้าจุลภาคนั้นใช้เทคนิคการสร้างพื้นฐานจากการสร้าง วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) จึงทำให้ได้ขนาดของอุปกรณ์ที่เล็ก ส่วนระบบการผลิตขึ้นส่วน ขนาดใหญ่นั้นจะใช้เทคนิคการสร้างที่ได้แก่ การกลึง การหล่อ การเจาะ การฉีด การรีด หรือการอัด เพื่อขึ้นรูปขึ้นงาน เทคนิคหรือวิธีการดังกล่าวไม่สามารถสร้างโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงได้เพราะมี ขีดจำกัดทางด้านรูปร่าง และสิ่งนี้เองที่เป็นข้อได้เปรียบของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค เนื่องจากสามารถ สร้างขึ้นงานขนาดเล็กและซับซ้อนได้มากกว่า ทำให้ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงความสะดวกต่อการ นำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่น

ปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นระบบกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-electromechanical system : MEMS) คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสายอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ นั้นได้เพิ่ม มากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญและต้องการความแม่นยำใน การทำงานที่สูง (G. Somlay et al., 2007) ตัวขับเร้าจุลภาค (Microactuator) ก็ถูกใช้อย่าง กว้างขวางในการขับเร้าโครงสร้างต่าง ๆ ในระบบกลไฟฟ้าจุลภาค การกระตุ้นตัวขับเร้าจุลภาคนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ฟิล์มเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric films), การใช้หลักการใน การขยายตัวของโลหะเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal expansion), การใช้หลักการของโลหะอัลลอยด์ ที่คืนรูปได้ (Shape memory alloy) และการใช้หลักการของฟ้าสถิต (Electrostatic forces) เป็น ต้น

#### 2.2 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงของงานวิจัยนี้จะสามารถทำงานได้ต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือกระจกจุลภาคทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางของแสง และส่วนที่สอง คือ ตัวขับเร้า จุลภาคทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระจกจุลภาคให้สามารถเคลื่อนที่ได้ ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงในงานวิจัยหลายชิ้นดังนี้

Koji Akimoto (1997) ได้ประดิษฐ์กระจกจุลภาคจากนิกเกิลที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซึ่ หวีเป็นตัวขับเคลื่อน โดยใช้เทคนิคการสกัดพื้นผิวนิกเกิล ซึ่งมีทั้งสร้างแม่พิมพ์ด้วยสารไวแสงและการ ชุบโลหะนิกเกิลด้วยไฟฟ้า กระจกจุลภาคนิกเกิลนี้มีความสูง 19 μm กว้าง 50 μm อุปกรณ์นี้มี สามารถวัดคุณลักษณะเฉพาะทั้งทางแสงและทางกล การสะท้อนแสงของกระจกจุลภาควัดได้จากการ ใช้สายใยแก้วนำแสงแบบ hemi-spherical-end ซึ่งเหมาะจะนะไปใช้วัดวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ระยะทางสูงสุดในการเคลื่อนที่คือ 5.5 μm วัดผลของการสะท้อนได้ประมาณ 63%



รูปที<mark>่ 2.1 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Koj</mark>i Akimoto

Raanan A. Miller (1997) ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงแบบ 2x2 สำหรับสายใย แก้วนำแสงแบบหลายโหมดซึ่งประกอบด้วยกระจกจุลภาคขนาดกว้าง 5 µm ยาว 3 mm และสูง 500 µm ขับเคลื่อนด้วยตัวขับเร้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะขึ้นลงตามแนวแกน z ควบคุมการ ทำงานจากชุดขดลวดทองแดงและสปริงที่ติดอยู่บนแผ่นซิลิคอน (Silicon) และถูกกระตุ้นจาก สนามแม่เหล็กภายนอกของแม่เหล็กโลกที่หายาก มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากเมื่อเทียบกับ อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ DiCon

	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Raanan	อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ DiCon		
Switching Time	10 ms	20 ms		
Switching Current	20-30 mA	130 mA		
Switching power	17-38 mW	650 mW		
Switch Size	< 1cm <sup>3</sup>	23 cm <sup>3</sup>		
Insertion Loss	0.062–3 dB	0.5–1 dB		
Loopback Path	2 5–11 dB	2–6 dB		
Loss				
Bypass Path Loss	2.3–2.5 <mark>d</mark> B	0.5 dB		

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Raanan กับ DiCon



Cornel Marxer (1999) ได้สร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงแบบ 2x2 สำหรับสายใยแก้วนำแสงแบบ โหมดเดียว อุปกรณ์นี้มีส่วนประกอบหลักในการทำงานอยู่สองส่วนได้แก่ กระจกจุลภาคแนวตั้งที่คอย ทำหน้าที่สวิตช์แสง และตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวีทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระจกจุลภาคให้ เคลื่อนที่เข้าออกระหว่างทางเดินแสงของสายใยแก้วนำแสงสองคู่ ใช้เทคนิคขึ้นรูปโครงสร้างโดยการ สกัดพื้นผิวซิลิคอนเชิงลึก และมีการเคลือบโลหะหลายชนิดเพื่อให้กระจกจุลภาคเกิดการสะท้อนแสง กระจกจุลภาคนี้มีความสูง 75 µm และมีความกว้างน้อยที่สุด 2.3 µm ตัวขับเร้าสามารถเคลื่อนที่ได้ 20 µm เมื่อป้อนแรงดัน 60 V

	ทองคำ อลูมิเนียม		นิกเกิล	โครเมียม	
การสะท้อน	97.5%	97%	72.1%	63%	
ความหนาของโลหะ	170 nm	100 nm	270 nm	320 nm	

ตารางที่ 2.2 ผลการจำลองค่าการสะท้อนแสงของโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่น 1310 nm

ตารางที่ 2.3 ค่าคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Cornel Marxer

	Switch off	Switch on		
Insertion loss	1.2 dB	1.8 dB		
Crosstalk attenuation	<-66 dB	<-50 dB		
Backreflection attenuation	<-40 dB	<-33 dB		
Switching speed	<1	ms		
Driving voltage	5 V C	EMOS		
Supply voltage (power)	5 V (70 mW)			



รูปที่ 2.3 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Cornel Marxer

Hiroshi Toshiyoshi (1999) ได้สร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงสำหรับสายใยแก้วนำแสงแบบหลาย โหมด ที่มีกระจกบิดขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นตัวสวิตช์แสงและถูกขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า อาศัย เทคนิคการขึ้นรูปด้วยการสกัดพื้นผิวซิลิคอน กระจกขนาดเล็กนี้เป็นทองคำ ติดอยู่กับคานบิดที่เคลือบ ฟิล์มแม่เหล็ก FeNiCo คานบิดนี้จะถูกควบคุมการทำงานด้วยสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้สามารถบิดไปรอบ ๆ แกนได้ เวลาในการสวิตซ์ 10-25 ms การสูญเสียจากการสะท้อน -2.5 dB และการสูญเสียจากการส่ง -0.83 dB



รูปที่ 2.4 อุปกรณ์สวิ<mark>ต</mark>ช์เชิงแ<mark>ส</mark>งของ Hiroshi Toshiyoshi

Shi-Sheng Lee (1999) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ 2x2 ด้วยระบบกลไฟฟ้า จุลภาคสำหรับสายใยแก้วนำแสงโหมดเดียว กระจกบิดจุลภาคแนวตั้งถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการ สกัดพื้นผิว (Surface-micromachined) ควบคุมการทำงานด้วยตัวขับเร้าที่ใช้หลักการในการ ขยายตัวของโลหะเนื่องจากอุณหภูมิ เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า 80 V จะทำให้กระจกบิดเป็นมุม 45 องศา เวลาในการสวิตช์น้อยกว่า 400 µs ค่าการสูญเสียทางแสงเนื่องจากการแทรกสอดได้ 1.25 dB



รูปที่ 2.5 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Shi-Sheng Lee

Ho Nam Khon (2004) ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ 2x2 สำหรับประยุกต์ ในการเพิ่มลดทางแสงที่มีการสูญเสียต่ำ ของสายใยแก้วนำแสงแบบปลายแบน (Flat-ended fiber) และสายใยแก้วนำแสงแบบปลายเฉียง (Beveled-ended fiber) มีกระจกจุลภาคเป็นตัวสวิตช์แสง และถูกขับเคลื่อนด้วยตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี อุปกรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการสกัด พื้นผิวซิลิคอนด้วยไอออนเชิงลึก (Silicon deep reactive ion etch : DRIE) เคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 40 µm ด้วยแรงดัน 24 V วัดค่า TDL (Time dependent loss), PDL (Polarization dependent loss) และ WDL (Wavelength dependent loss) ที่ Pi (Input port), Po (Output port), Pa (Add port) และ Pd (Drop port) ได้ดังนี้

Optical		Flat-enc	led fiber		Beveled-ended fiber			er
Characteristics	Swite	ch off	Switc	h on	Swite	ch off	Switc	h on
Characteristics	Pi-Po	Pa-Pd	Pa-Po	Pi-Pd	Pi-Po	Pa-Pd	Pa-Po	Pi-Pd
TDL (dB)	0.06	0.02	0.24	0.33	0.01	0.04	0.01	0.03
PDL (dB)	0.13	0.05	0.28	0.41	0.05	0.05	0.03	0.05
WDL (dB)	0.48	1.11	0.61	1.24	0.28	0.68	0.71	0.24
Extinction	_						31	30
ratio				Z			51	JZ
Response								
time	5 115							
E						10		

ตารางที่ 2.4 ค่าคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สวิ<mark>ตช์</mark>เชิงแสงของ Ho Nam Khon

<sup>3</sup> <sup>1</sup> วักยาลัยเทคโนโลยีสุรบโ



รูปที่ 2.6 อุปกรณ์สวิ<mark>ตช์เ</mark>ชิงแสงของ Ho Nam Khon

Chang-Hyeon Ji (2004) ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ 2x2 ด้วยระบบกล ไฟฟ้าจุลภาค ประกอบด้วยกระจกจุลภาคเคลือบทองคำที่สร้างขึ้นจากกระบวนการสกัดพื้นผิวซิลิคอน ด้วยไอออนเชิงลึก ที่อยู่บนส่วนปลายของคานบิด ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเกิด จากขดลวดเหล็ก กระจกจุลภาคนี้มีความกว้าง 2 µm ทดสอบการทำงานที่ความยาวคลื่น 1550 nm มีค่าการสูญเสียจากการแทรกสอด 0.2-0.8 dB และการสูญเสียจากการโพลาไรซ์ 0.02-0.2 dB เวลา ในการสวิตช์คือ 1 ms



รูปที่ 2.7 อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของ Chang-Hyeon Ji

เพิ่ม paper อ้างอิงปีใหม่ๆ อีก 1 ชิ้น

จากงานวิจัยที่ได้ทำการสำรวจพบว่ากระบวนการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง มีรูปแบบการสร้าง ที่หลากหลายได้แก่ การสร้างชิ้นงานด้วยการสกัดฐานรองเป็นโครงสร้างลงไปหรือเรียกว่า Bulk micromachining และสร้างชิ้นงานด้วยงานสร้างลวดลายบนพื้นผิวของฐานรองหรือเรียกว่า Surface micromachining ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การสร้างชิ้นงานด้วยการสกัดฐานรอง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัสดุประเภทซิลิคอนต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาสูง แต่มีความแม่นยำใน การสร้าง การควบคุมอัตราการเกิดหรือการสกัดค่อนข้างแม่นยำ ส่วนอีกวิธีคือสร้างชิ้นงานบนพื้นผิว ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ราคาไม่แพงมาก

สำหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนากระบวนการสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงด้วย เทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาค โดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์ เนื่องจากกรังสีเอกซ์มี ค่าของพลังงานที่สูงกว่ารังสีอัลตราไวโอเลตหลายเท่าทำให้ได้ชิ้นงานจากกระบวนการฉายแสงที่มีผนัง เรียบตรงและตั้งฉากกับฐานรอง อันเป็นข้อดีของการสร้างโครงสร้างด้วยรังสีเอกซ์ ซึ่งจะช่วยให้ สามารถสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีแรงขับที่สูงขึ้นโดยใช้แรงดันขับเคลื่อนน้อยและมีพื้นผิวสำหรับ สวิตช์แสงที่เรียบขึ้นเมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเทคนิคดั้งเดิม โดยในขั้นต้นนี้จะเน้นการแก้ปัญหา กระบวนการผลิตให้สามารถผลิตอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงให้สามารถเคลื่อนที่ได้จริงและสวิตซ์แสงได้ก่อน แล้วจึงปรับปรุงคุณลักษณะการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป



# บทที่ 3 กระบวนการพื้นฐานในการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาค

การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค โดยพื้นฐานนิยมใช้กระบวนการ ลิโธกราฟฟี เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับสร้างวงจรรวม (Integrated circuit : IC) ซึ่งประกอบด้วยการฉายแสง การล้างสารไวแสง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ กระบวนการลิโธกราฟีในการผลิตอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิค อื่นร่วมด้วย คือ การเคลือบโลหะด้วยเทคนิคสปัตเตอริง (Sputtering) เพื่อให้อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง สามารถสะท้อนแสงและนำไฟฟ้าได้

#### 3.1 กระบวนการลิโธกราฟฟี

กระบวนการลิโธกราฟฟี (Lithography process) เป็นกระบวนการที่สำคัญในเทคโนโลยีระบบ กลไฟฟ้าจุลภาค คือการใช้กระบวนการทางเคมีในการถอดแบบลวดลายจากลวดลายต้นแบบที่มี ลักษณะเป็นลายเส้นทีบแสงลงบนพื้นผิวเรียบ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างลวดลายลงบนวัสดุต่าง ๆ ที่มี ลักษณะเป็นสายเส้นทีบแสงลงบนพื้นผิวเรียบ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างลวดลายลงบนวัสดุต่าง ๆ ที่มี ลักษณะเป็นพื้นผิวเรียบ ในกระบวนการถอดแบบจะใช้สารเคมีที่เรียกว่าสารไวแสง (Photoresist) เป็นวัสดุในการถอดแบบ คุณสมบัติทางกายภาพของสารไวแสงคือจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแสงมาตก กระทบ สารไวแสงสามารถจำแนกได้เป็นสองชนิด คือ สารไวแสงชนิดบวก (Positive photoresist) จะมีคุณสมบัติที่เมื่อมีแสงมาตกกระทบในบริเวณใดบริเวณนั้นจะสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำยา ดีเวลอปเปอร์เหลือไว้เฉพาะบริเวณที่ไม่มีแสงมาตกกระทบ และอีกชนิดหนึ่งได้แก่ สารไวแสงชนิดลบ (Negative photoresist) ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับสารไวแสงชนิดบวก กล่าวคือบริเวณใดที่ไม่มี แสงมาตกกระทบจะถูกล้างออกได้ด้วยน้ำยาดีเวลอปเปอร์ เหลือไว้เฉพาะบริเวณที่มีแสงมาตกกระทบ เท่านั้น จากคุณสมบัติของสารไวแสงทั้งสองชนิดทำให้สามารถสร้างลวดลายในกระบวน การลิโธกราฟฟีออกมาได้สองแบบขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สารไวโอเลต (Ultra-violet : UV) ซึ่งกระบวน การลิโธกราฟฟีทั้งกระบวนการโดยสังเขปสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็น ข้อแตกต่างระหว่างการใช้สารไวชนิดบวก (ก) และการใช้สารไวแลงชนิดลบ (ข)



รูปที่ 3.1 เ<mark>ปรียบ</mark>เท<mark>ียบการใช้สารไวแสงสองชนิ</mark>ดใน<mark>กระ</mark>บวนการลิโธกราฟฟี

### 3.2 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

หลังจากสร้างลวดลายลงบนฐานรองด้วยกระบวนการลิโธกราฟฟีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเติม โลหะเข้าไปในช่องว่างของสารไวแสงเพื่อเป็นสำหรับหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ สำหรับอุปกรณ์สวิตซ์เชิง แสงในงานวิจัยนี้จะต้องมีการเติมวัสดุดูดกลื่นรังสีเอกซ์ ซึ่งจะใช้โลหะเงินเป็นลวดลายสำหรับดูดกลืน รังสีเอกซ์ อยู่บนแผ่นกราไฟต์ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสงต่อรังสีเอกซ์ การเติมโลหะเงินลงบนฐานรองเพื่อ ใช้เป็นลวดลายกั้นรังสีเอกซ์นั้นจะใช้วิธีการชุบด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการ สร้างชิ้นงานและราคาถูก โดยใช้กระบวนการไฟฟ้าเคมีซึ่งไอออนของโลหะที่เป็นขั้วแอโนด (Anode) จะผ่านสารละลายมาเคลือบบนชิ้นงานซึ่งเป็นขั้วแคโธด (Cathode) โดยป้อนกระแสไฟฟ้าคงที่ การ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอจะขึ้นอยู่กับการรักษาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสม ตลอดกระบวนการ ในรูปที่ 3.2 เป็นตัวอย่างวงจรสำหรับชุบเงินด้วยไฟฟ้าซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมี อุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพดีขึ้น เช่น วงจรสร้างสัญญาณพัลส์ (Pulse plating) สารละลายมีอุณหภูมิที่เหมาะสม จากรูปที่ 3.2 อุปกรณ์สำหรับชุบโลหะเงิน ประกอบด้วย ชุด แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง สารละลาย และชิ้นงาน การต่อวงจรทำได้โดยนำชิ้นงานต่อเข้าที่แคโธด และแผ่นแพลตตินัมต่อเข้าที่แอโนด เมื่อเกิดกระแสไหลเงินจะก่อตัวที่ผิวของชิ้นงานจนได้ความหนา ตามต้องการจึงหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า



รูปที่ 3.2 การชุบโลหะเงินด้วยไฟฟ้า

#### 3.3 การเคลือบโลหะด้วยการสปัตเตอริง

เทคนิคการเคลือบโลหะส่วนใหญ่แล้วเน้นเคลือบวัสดุที่เป็นฉนวนให้สามารถนำไฟฟ้าได้ซึ่งจะได้ ความหนาในระดับนาโนเมตร ในงานวิจัยนี้จะเสนอกระบวนการเคลือบโลหะด้วยเทคนิค การสปัตเตอริง มีหลักการดังนี้

การสปัตเตอริง (Sputtering) อาศัยหลักการสร้างพลาสมาของแก๊สเฉื่อย Ar<sup>+</sup> และเหนี่ยวนำให้ พุ่งเข้าชนโลหะเป้าหมาย (พิทยา ดีกล้า, 2009) อะตอมของโลหะเป้าหมายจะกระเจิงออกมาเคลือบ บนชิ้นงาน การสปัตเตอริงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด การสร้างพลาสมาด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC sputtering) เหมาะสำหรับวัตถุเป้าหมายที่เป็นโลหะและการสร้างพลาสมาด้วยแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ (RF sputtering) เหมาะสำหรับวัตถุเป้าหมายที่เป็นตัวนำหรือฉนวนดังรูปที่ 3.3 ระบบ เคลือบวัสดุด้วยวิธีสปัตเตอริง



รูปที่ 3.3 เครื่องเคลือบโลหะแบบสปัตเตอริง

#### 3.4 การเตรียมสารไวแสง

จากตัวอย่างของสารไวแสงซึ่งเป็นวัสดุสำหรับการสร้างลวดลายชิ้นงาน หรือสร้างเป็นแม่พิมพ์มี สองชนิดคือชนิดลบและชนิดบวก การเตรียมสารไวแสงสำหรับกระบวนการลิโธกราฟฟีสามารถเตรียม ได้จากการหมุนเคลือบ การหยด หรือการหล่อจากผงสารไวแสง ในรูปที่ 3.4 เป็นขั้นตอนการหมุน เคลือบสารไวแสงชนิดลบ SU-8 และเครื่องเครื่องสำหรับหมุนเคลือบสารไวแสง



รูปที่ 3.4 การเตรียมสารไวแสงด้วยการหมุนเคลือบ

นอกจากการเตรียมสารไวแสงด้วยวิธีหมุนเคลือบแล้ว ยังสามารถใช้วิธีหยดสารไวแสงได้ด้วย ซึ่ง วิธีนี้เป็นการนำสารไวแสงแบบเหลวมาหยดลงบนวัสดุที่ใช้เป็นฐานรอง ดังรูปที่ 3.5 ซึ่งข้อดีของวิธีการ นี้คือการเตรียมสารไวแสงไม่ยุ่งยาก



รูปที่ 3.5 <mark>การ</mark>เตรียมสา<mark>รไว</mark>แสงด้วยการหยด

วิธีการเตรียมสารไวแสงอีกวิธีหนึ่งคือ การหล่อสารไวแสงจากผงแห้ง ซึ่งสารไวแสงชนิดผงแห้งนี้ ได้มาจากการนำสารไวแสงชนิดเหลวไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วนำมาบดให้เป็นผง จากนั้น นำสารไวแสงผงไปผ่านความร้อนในห้องสุญญากาศ โดยรูปที่ 3.6 เป็นระบบการหล่อสารไวแสงผงเพื่อ ใช้เป็นวัสดุสำหรับสร้างลวดลายที่เน้นความสูงของโครงสร้างชิ้นงาน เหมาะกับกระบวน การลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอกซ์ และรูปที่ 3.7 คือชั้นของสารไวแสงหลังจากการหล่อผงแห้ง





รูปที<mark>่ 3.6 กระบวนการหล่อสารไวแสงจากผงแห้ง</mark>และอุปกรณ์



## รูปที่ 3.7 ชั้นของสารไวแสงหลังจากการเตรียมสารไวแสง

### 3.5 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์

ในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์นั้น สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการอย่างมากคือ หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ (วินัย วันบุรี, 2007) ซึ่งทำหน้าที่เป็นลวดลายต้นแบบ ในกรณีการลิโธกราฟฟี ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ลวดลายต้นแบบหรือหน้ากากกั้นแสงจะเป็นลวดลายที่อยู่ในรูปของหมึกทึบ แสงที่อยู่บนวัสดุโปร่งแสง อาจจะเป็นลวดลายบนแผ่นใสหรือบนกระจกก็ได้ แต่ในกรณีของหน้ากาก กั้นรังสีเอกซ์นั้น ลวดลายจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถดูดกลืนรังสีเอกซ์ได้ดี และอยู่บนวัสดุที่มีความโปร่ง แสงได้ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งวัสดุที่สามารถดูดกลืนรังสีเอกซ์ได้ดีนั้นก็ได้แก่ทองคำ เงิน อลูมิเนียม เป็นต้น การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ รูปที่ 3.8

1. หมุนเคลือบสารไวแสงลงบนแผ่นกราไฟต์ (Graphite) ที่ทำความสะอาดแล้ว

 2. ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตผ่านหน้ากากกั้นรังสีเพื่อให้เนื้อสารไวแสงบริเวณที่ถูกแสงทำปฏิกิริยา และเกิดลวดลาย

ล้างสารไวแสงบริเวณที่ไม่แข็งตัวทิ้ง

ชุบโลหะเงินเพื่อเป็นวัสดุดูดซับรังสีเอกซ์ด้วยไฟฟ้า



รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์

การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างลวดลายของอุปกรณ์ สวิตซ์เชิงแสงให้สามารถขึ้นรูปด้วยสารไวแสงชนิดลบ SU-8 ที่มีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างมาก ๆ ได้ โดยงานวิจัยนี้หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์จะถูกสร้างขึ้นจากสารไวแสงชนิดลบ SU-8 ซึ่งจะอยู่บน ฐานรองกราไฟต์และมีวัสดุสำหรับดูดกลืนรังสีเอกซ์เป็นโลหะเงิน

การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์สำหรับสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงนั้น สามารถแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนและผลการสร้างอย่างละเอียดได้ดังนี้ เริ่มจากยึดแผ่นกราไฟต์กับกระจกด้วยเทปกันความร้อน (PI tape) แล้วทำความสะอาดแผ่นกราไฟต์โดยการเซ็ดด้วยสำลีชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) แล้วเซ็ดด้วยสำลีอีกครั้ง หลังจากนั้นเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจน แล้วนำไปวางบน แผ่นความร้อน (Hot plate) ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อไล่ความชื้น ต่อจากนั้นทำการเคลือบสารไวแสงชนิดลบ SU-8 เบอร์ 3050 ลงบนฐานรองกราไฟต์ดังกล่าว ด้วย เครื่องหมุนเคลือบ Laurell รุ่น WS-400B-6NPP/LIT ที่ความเร็ว 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาที แล้ว หมุนต่อเนื่องอีกด้วยความเร็ว 2000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งจะได้ความหนาประมาณ 60 μm จากนั้นนำไปวางบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เสร็จแล้วปิด สวิตซ์แผ่นความร้อนแล้วปล่อยชิ้นงานให้ค่อย ๆ เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 26.6 องศา เซลเซียส อีก 1 ชั่วโมง จะได้ฐานรองสำหรับสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 ฐานรองสำหรับสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์

หลังจากหมุนเคลือบสารไวแสงบนแผ่นกราไฟต์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการฉายแสง อัลตราไวโอเลตจากเครื่อง Quintel Q4000 ที่ความเข้มแสง 19.75 mw/cm<sup>3</sup> ผ่านหน้ากากกั้นแสงที่ อยู่ในรูปหมึกทึบแสง เป็นเวลา 15 วินาที ซึ่งจะได้พลังงานสะสมตกกระทบเนื้อสารไวแสงเท่ากับ 296.25 mJ/cm<sup>2</sup> จากนั้นนำมาวางบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้สารไวแสงบริเวณที่ทำปฏิกิริยากับแสงแข็งตัว จากนั้นจึงปิดสวิตช์แผ่นความร้อนแล้วปล่อย ชิ้นงานให้ค่อย ๆ เย็นตัวลง ต่อจากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ไปแช่สารละลาย SU-8 developer เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้สารไวแสงบริเวณที่ไม่แข็งตัวหลุดออก จากนั้นฉีดล้างชิ้นงานด้วย ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบสารไวแสงที่ยังตกค้างอยู่ ซึ่งหากมีสารไวแสงตกค้างก็จะเกิด คราบขาวขึ้น ก็ให้นำไปแช่ในสารละลาย SU-8 developer ต่อจนกว่าสารไวแสงที่ตกค้างจะ ออกจนหมด จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้มาเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจนเบา ๆ จนแห้ง ก็จะได้ชิ้นงานสำหรับ นำไปเติมวัสดุกั้นรังสีเอกซ์ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 <mark>ลวด</mark>ลายหลังฉายแสงขอ<mark>งห</mark>น้ากากกั้นรังสีเอกซ์ สำหรับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลิโธกราฟฟีแล้ว กระบวนการต่อมาคือการเติมวัสดุดูดซับรังสีเอกซ์ โดย การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในสารละลายเงินสำเร็จรูป โดยใช้แท่งแพลทินัม (Platinum) ต่อกับแหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้าขั้วบวก (Anode) แล้วจุ่มลงไปในสารละลายเงินที่เตรียมไว้ และให้ชิ้นงานที่ต้องการเติม โลหะต่อกับขั้วลบ (Cathode) แล้วจุ่มลงไปในสารละลายเงินที่เตรียมไว้เช่นกัน แต่ก่อนจะจุ่มชิ้นงาน ลงไปในสารละลายนั้นจะต้องนำชิ้นงานไปจุ่มในน้ำสะอาด (DI water) เพื่อให้ชิ้นงานสามรถนำไฟฟ้า ได้ถั่วถึงทั้งชิ้นเสียก่อน จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยความหนาแน่นกระแส 20 mA/cm<sup>2</sup> เป็นเวลา 10 นาที แล้วลดความหนาแน่นกระแสลงจนเหลือ 10 mA/cm<sup>2</sup> และทำการซุบโลหะต่อเนื่องไปอีกเป็น เวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นให้ปรับลดกระแสไฟฟ้าลงจนเหลือ 0 mA ต่อจากนั้นนำชิ้นงานออกจาก สารละลายแล้วจุ่มล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงเป่าชิ้นงานให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน จากนั้นนำชิ้นงาน ดังกล่าวไปวัดความหนาของโลหะเงินด้วยเครื่อง veeco WYKO NT1100 ซึ่งจากกระบวนการ ดังกล่าวจะทำให้ได้หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ที่มีความหนาของโลหะเงินอยู่ที่ 40 μm ดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 หน้ากากกั้นรัง<mark>สีเ</mark>อกซ์สำหรับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

หลังจากได้หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำหน้ากากเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการ ลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อเป็นลวดลายต้นแบบสำหรับขึ้นรูปโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสง ซึ่งจะ กล่าวถึงกระบวนการสร้างอย่างละเอียดในบทที่ 5 ต่อไป

### 3.6 การสร้างลวดลายบนแผ่นว<mark>งจร</mark>พิมพ์

การสร้างลวดลายบนแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับใช้เป็นฐานรองโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์ เชิงแสงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ตัดแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 2x2 นิ้ว จากนั้นใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 800 ขัดผิวหน้า แผ่นวงจรพิมพ์บริเวณที่เป็นทองแดงจนใส แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้นเป่าด้วย แก๊สไนโตรเจนจนแห้ง จะได้แผ่นวงจรพิมพ์ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แผ่นวงจรพิมพ์

 2. ตัดฟิล์มไวแสง (Dry film) ให้ใหญ่กว่าแผ่นวงจรพิมพ์เล็กน้อย จากนั้นลอกแผ่นพลาสติก (Cover sheet) ที่ติดอยู่ด้านในแผ่นฟิล์มไวแสงออก แล้วนำฟิล์มไวแสงดังกล่าวไปติดกับ แผ่นวงจรพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยการนำไปรีดด้วยเครื่องรีดแผ่นใสที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จนไม่มี ฟองอากาศ ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 <mark>ติดแ</mark>ผ่นฟิล์มไ<mark>วแส</mark>งบนแผ่นวงจรพิมพ์

 3. ฉายแสงอัลตราไวโอเลตลงบนฟิล์มไวแสงผ่านหน้ากากกั้นแสงหมึกทึบด้วยเครื่องฉายแสง หลอดอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นลอกแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่อีกด้านของแผ่นฟิล์มไวแสง ออก ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 ฉายแสงอัลตราไวโอเลตบนฟิล์มไวแสง
4. ผสมน้ำยาล้างฟิล์มไวแสงโดยใช้ผงดีเวลอปเปอร์ (Developer) 1 กรัม ต่อน้ำสะอาด 100 มิลลิลิตร คนจนผงดีเวลอปเปอร์ละลาย จากนั้นนำแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผ่านการฉายแสงแล้วลงไปแช่ใน น้ำยาล้างฟิล์มไวแสงที่เตรียมไว้ โดยในขณะที่แช่ให้ใช้ฟองน้ำลูบผิวหน้าแผ่นวงจรพิมพ์เบา ๆ จนกระทั่งเห็นลวดลายเด่นชัดไม่มีส่วนของฟิล์มไวแสงที่ไม่ต้องการตกค้างอยู่ หลังจากนั้นนำมาล้างน้ำ สะอาดแล้วเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจนจนแห้ง

5. นำแผ่นวงจรพิมพ์ที่ได้จากข้อ 4 ไปแซ่ในน้ำยากัดทองแดงและเขย่าภาชนะไปมาเบา ๆ พร้อม ทั้งตรวจสอบว่าพื้นผิวทองแดงในส่วนที่ไม่ต้องการถูกกัดออกจนหมดแล้ว จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำ สะอาด เสร็จแล้วจึงใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 1200 ขัดฟิล์มไวแสงที่ปกคลุมลายเส้นออกจนเห็น ลายเส้นที่เป็นทองแดงอย่างชัดเจน แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วเป่าให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน ก็จะได้ฐานรองสำหรับโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์<mark>เชิ</mark>งแสงดังรูปที่ 3.15



หลังจากได้ฐานรองจากแผ่นวงจรพิมพ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำแผ่นวงจรพิมพ์นี้ไปใช้เป็น ฐานรองโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในบทที่ 5 ต่อไป

# บทที่ 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เพื่อจำลองระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการ วิเคราะห์ผล การทดสอบและการควบคุมระบบอีกด้วย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สามารถหาได้จาก การวิเคราะห์ทฤษฎีซึ่งทำให้ได้มาซึ่งฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) จากนั้นนำฟังก์ชันถ่ายโอน ดังกล่าวไปหาค่าพารามิเตอร์ของระบบด้วยการวัดพร้อมกับนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการจำลอง เพื่อทำการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระบบจริงต่อไป

การออกแบบอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงในงานวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ โครงสร้างที่เหมาะสมจากงานวิจัยต่าง ๆ แล้วทำการปรับปรุงขนาดโครงสร้างตลอดจนกระบวนการ สร้างให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และเครื่องมือ<mark>ที่มีอยู่ใน</mark>ห้องปฏิบัติการ

#### 4.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายใยแก้<mark>วน</mark>ำแสง

สายใยแก้วนำแสง (Optical fibers) คือ สายนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้หลักการทางแสง กล่าวคือ ใช้กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูปของคลื่นแสงเท่านั้น ตัวแก้วนำแสงอาจทำจากแก้วหรือพลาสติก โดย สัญญาณข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นแสงแล้วส่งให้เดินทางสะท้อนภายในสายใยแก้วเรื่อยไปจนถึง ผู้รับที่ปลายทาง สายใยแก้วนำแสงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสายทั่วไปหลายประการ เช่น มีขนาดเล็ก ส่งผ่านข้อมูลได้ครั้งละมาก ๆ สัญญาณข้อมูลมีโอกาสถูกลดทอนน้อยมาก ทำให้การสื่อสารมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนข้อจำกัดคือเมื่อสายใยแก้วขาดหรือแตกหักจำเป็นต้องอาศัย อุปกรณ์พิเศษในการซ่อมแซม ซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบอื่น ลักษณะของสายใยแก้วนำ แสดงแสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 <mark>สายใยแก้วนำแสง</mark>

ยีสร

# 4.1.1 โครงสร้างของสายใยแก้วน้ำแสง

สายใยแก้วนำแสงประกอบด้วยส่วนที่สำคัญด้วยกัน 3 ส่วน ดังรูปที่ 4.2 ได้แก่ ส่วนที่ แสงเดินทางผ่านเรียกว่า core, ส่วนที่หุ้ม core อยู่เรียกว่า clading ซึ่งทั้ง core และ clading มี คุณสมบัติเป็น dielectric ใส 2 ชนิด (dielectric หมายถึงสารที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น แก้ว พลาสติก) ซึ่งการที่แสงจะเดินทางไปใน core ได้นั้นจะต้องทำให้ค่าดัชนีการหักเหของ clading มีค่า น้อยกว่าค่าดัชนีการหักเหของ core เล็กน้อยประมาณ 2~3% และอาศัยปรากฏการณ์สะท้อนกลับ หมดของแสงจึงจะสามารถทำให้แสงที่ป้อนเข้าไปใน core เดินทางไปได้ และส่วนสุดท้ายคือ buffer coating ทำหน้าที่ป้องกันส่วน core และ cladding ในปัจจุบันขนาดของสายใยแก้วนำแสงที่ใช้อยู่ ได้แก่ 9/125 50/125 และ 62.5/125 ดังรูปที่ 4.3



4.1.2 ชนิดของสายใยแก้วน้ำแสง

สายใยแก้วนำแสงสามารถแบ่งแยกได้ตามคุณสมบัติของตัวนำแสง ว่ามีลักษณะการส่อง ทะลุผ่านของแสงเป็นแบบใด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบโหมดเดียว และแบบหลาย โหมด

#### 4.1.2.1 สายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว (Single mode optical fibers)

สายใยแก้วนำแสงชนิดนี้สามารถที่จะสร้างให้มี index profile ได้ทั้งแบบ step index และ graded index แต่เนื่องจากการสร้างสายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียวที่มี index profile แบบ graded index มีราคาแพงอีกทั้งคุณสมบัติที่ได้จากการมี index profile แบบ graded index ก็ไม่มีประโยชน์ต่อระบบการสื่อสารด้วย ดังนั้นในปัจจุบันสายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียวที่ สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์จึงมีแต่แบบ step index เท่านั้น

สายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียวแบบ step index นี้เหมาะสำหรับงานที่ ต้องการแบนด์วิดท์ (Bandwidth) กว้างและการส่งข้อมูลในระยะทางไกล (Long-Haul) โดยทั่วไป สายใยแก้วนำแสงชนิดนี้จะสร้างจากแก้วซิลิกา (Silica) เพื่อให้มีการลดทอนสัญญาณต่ำ ถึงแม้ว่า สายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียวจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ core เล็ก แต่ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางของ clading ก็จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ core อย่างน้อย 10 เท่า เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการเลือนหายของสนามไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อรวมขนาดของ buffer coating ด้วยแล้วขนาดโดยรวมของสายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียวก็จะใกล้เคียงกับ สายใยแก้วนำแสงชนิดอื่น โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียวแสดงให้ดูในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.<mark>4 โค</mark>รงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว

a	~ ¥	ຄ	2 0	2 6	A
ตารางท่ 11	โครงสรางขอ	งสายไยแ	กาบา	แสงชาวดโร	หาดเดยา
N 10 10 1 4.1	6110 1010 11 00	10110000	511010	1000110000101	101110100

5	โครงสร้าง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ core	5 ถึง 10 µm โดยปกติอยู่ที่ประมาณ 8.5 µm
เส้นผ่านศูนย์กลางของ clading	โดยทั่วไปมีขนาด 125 µm
เส้นผ่านศูนย์กลาง buffer coating	250 ถึง 1000 μm
Numerical Aperture	0.08 ถึง 0.15 โดยทั่วไปมีค่าประมาณ 0.1

ตารางที่ 4.2 คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียว

ନ୍	ุณลักษณะทางประสิทธิภาพ
	2 ถึง 5 dB/km โดยที่ความยาวคลื่น 850 nm จะมีการ
0050000100000	ลดทอนประมาณ 1 dB/km และมีการลดทอนโดยเฉลี่ย 0.35
ก เวลตทอนสะบิรถิ เรา	และ 0.21 dB/km ที่ความยาวคลื่น 1310 nm และ 1550 nm
	ตามลำดับ
	มากกว่า 500 MHz·km ในทางทฤษฎีแบนด์วิดท์ จะถูกจำกัด
	โดยความยาวคลื่นและ material dispersion โดยจะมี
แบนด์วิดท์	ค่าประมาณ 40 GHz ที่ความยาวคลื่น 850 nm ในทางปฏิบัติ
	แล้วแ <mark>บน</mark> ด์วิดท์ ที่มากกว่า 10 GHz จะต้องใช้ความยาวคลื่น
	1310 nm
ດດະໃຫ້ທານ	เหม <mark>าะกับระ</mark> บบที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงและระยะทางไกลมาก
1112607178	โดย <mark>จ</mark> ะใช้ LD เป็นอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณแสง

4.1.2.2 สายใยแก้วนำแ<mark>สงช</mark>นิดหลายโหมด (Multi mode optic fibers)

สายใยแก้วนำแสงชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ core ประมาณ 50 หรือ 62.5 μm และเมื่อรวมกับ cladding จะทำให้มีขนาดประมาณ 125 μm เนื่องจากขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ core มีขนาดใหญ่ ดังนั้นแสงที่ตกกระทบที่ด้านปลาย input ของสายจะมีมุมตกกระทบที่แตกต่างกันหลายค่า และจากหลักการสะท้อนกลับหมดของแสงที่ เกิดขึ้นภายในส่วนของ core ทำให้มีแนวของลำแสงเกิดขึ้นหลายโหมด โดยแต่ละโหมดใช้ระยะเวลา ในการเดินทางที่แตกต่างกัน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกกระจายของแสง (Mode dispersion) สายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดมี 2 แบบได้แก่ Step index และ Grade index

1. สายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Step index

สายใยแก้วนำแสงชนิดนี้อาจจะสร้างจากแก้วหลาย ๆ ชนิดปนกันหรือ แก้วซิลิกาก็ได้ โดยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ core ขนาดใหญ่เพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ (Coupling) สัญญาณกับแหล่งกำเนิดแสงแบบ Incoherent เช่น LED คุณลักษณะทางประสิทธิภาพ ของสายใยแก้วนำแสงชนิดนี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามสารที่ใช้สร้างและกระบวนการในการเตรียม สาร ซึ่งโครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดนี้แสดงให้ดูดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Step index

โครงสร้าง				
เส้นผ่านศูนย์กลางของ core		50 ถึง 400 µm สร้างของเส้นใยแสง		
เส้นผ่านศูนย์กลางของ clad		125 ถึง 500 µm		
เส้นผ่านศูนย์กลางของ buffer coat <mark>ing</mark>		250 ถึง 1000 μm		
Numerical Aperture		0.16 ถึง 0.5		

ตารางที่ 4.3 โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสง<mark>ชนิ</mark>ดหลายโหมดแบบ Step index

## ตารางที่ 4.4 คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วน้ำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Step index

คุณลักษณะทางประสิทธิภาพ				
	2.6 ถึง 50 dB/km <mark>ที่ความ</mark> ยาวคลื่น 850 nm ถูกจำกัดโดย			
การลดทอนสัญญา <mark>ณ</mark>	<mark>การดูดกลืนและการ</mark> กระจาย ส่วนการลดทอนที่ความยาว			
512	คลื่นอื่นแสดงให้ดูดังรูปที่ 4.6			
แบนด์วิดที่ 18าลไ	ป <b>ทอโปโล 6</b> ถึง 50 MHz·km			
ດດະໃຫ້ມານ	เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในโครงข่ายแบบ Short-Haul ที่มี			
1113604.17	แบนด์วิดท์จำกัด และใช้กับงานที่ราคาไม่สูง			



2. สายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index

สร้างจาก<mark>แก้วหลายชนิดปนกันหรื</mark>อแก้วซิลิกาก็ได้เช่นเดียวกับชนิดหลาย

โหมดแบบ Step index แต่จะแตกต่างกันตรงสารที่นำมาใช้จะต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่าเพื่อลดการ สูญเสียที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้สายใยแก้วนำแสงชนิดนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าสายใยแก้วนำแสงชนิดหลาย โหมดแบบ Step index โครงสร้างโดยทั่วไปของสายชนิดนี้แสดงให้ดูดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 โครงสร้างโดยทั่วไปของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index

โครงสร้าง		
เส้นผ่านศูนย์กลางของ core	30 ถึง 100 μm	
เส้นผ่านศูนย์กลางของ clad	100 ถึง 150 µm	
เส้นผ่านศูนย์กลางของ buffer coating	250 ถึง 1000 μm	
Numerical Aperture	0.2 ถึง 0.3	

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index

ตารางที่ 4.6 คุณลักษณะเฉพาะของสายใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมดแบบ Graded index

คุณเ	ลักษณะทางประสิทธิภาพ
การลดทอนสัญญาณ	2 ถึง 10 dB/km ที่ความยาวคลื่น 850 nm ถูกจำกัดโดย การกระจาย ส่วนการลดทอนสัญญาณโดยเฉลี่ยที่ความยาว คลื่น 1310 nm มีค่าเท่ากับ 0.4 และ 0.25 dB/km ตามลำดับ
แบนด์วิดท์	300 MHz·km ถึง 3 GHz·km
การใช้งาน	เหมาะสมที่สุด <mark>สำห</mark> รับใช้ในโครงข่ายแบบ Medium-Haul ที่ มีแบนด์วิดท์ปาน <mark>กลา</mark> งถึงสูง ซึ่งใช้ LED หรือ LD เป็นอุปกรณ์ กำเนิดสัญญาณแสง

## 4.1.3 หัวเชื่อมต่อ (Connector)

การเชื่อมต่อ<mark>สายใยแก้วนำแสงสามารถทำได้โดยการใช้</mark>หัวเชื่อมต่อแบบสำเร็จรูป ซึ่งจะ ทำให้มีความสะดวกในการถอด<mark>ได้ตามความจำเป็น หัวเชื่อมต่</mark>อสำหรับสายใยแก้วนำแสงมีหลายชนิด ดังตารางที่ 4.7 <sup>7</sup>วักยาลัยเทคโนโลยีสุรุบ

ตารางที่ 4.7 คุณสมบัติของหัวเชื่อมต่อชนิดต่าง ๆ

Connector	Insertion Loss	Repeatability	Fiber Type	Application
FC Connector	0.50-1.00 dB	0.20 dB	Single Mode (SM) Multi Mode (MM)	Datacom, Telecom
ST Connector	0.40 dB (SM) 0.50 dB (MM)	0.40 dB (SM) 0.20 dB (MM)	Single Mode (SM) Multi Mode (MM)	Inter-Building, Intra-Building, Security, Navy

Connector	Insertion Loss	Repeatability	Fiber Type	Application
			Single Mode	
SC Connector	0.20-0.45 dB	0.10 dB	(SM) Multi Mode	Datacom
			(MM)	
	0 15 dR (SM)		Single Mode	High Donsity
LC Connector	0.15  dB(300)	0.20 dB	(SM) Multi Mode	
			(MM)	Interconnection
רטט			Single Mode	Fiber Optic
Connector	0.20-0.70 dB	0.20 dB	(SM) Multi Mode	Fiber Optic
Connector			(MM)	NELWOIK

## 1. หัวต่อแบบเอฟซี (FC Con<mark>necto</mark>r)

หัวต่อชนิดนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัท เอ็นทีที (NTT) แห่งญี่ปุ่น ได้รับความนิยม มากที่สุดในญี่ปุ่นรวมทั้งสหรัฐและยุโรป ส่วนมากหัวต่อแบบนี้จะถูกนำไปใช้งานทางด้านเครือข่าย โทรศัพท์เนื่องจากอาศัยการขันเกลียวเพื่อยึดติดกับหัวปรับ ข้อดีของหัวต่อประเภทนี้ ได้แก่ การ เชื่อมต่อที่แน่นหนา แต่ข้อเสียคือการเข้าหัวสายเชื่อมต่ออาจต้องเสียเวลามาก

#### 2. หัวต่อแบบเอสที่ (ST Connector)

หัวต่อชนิดนี้ออกแบบโดย AT&T สำหรับการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงภายในอาคาร สำนักงาน เครือข่าย LAN หัวต่อแบบเอสทีเหมาะสำหรับงานที่ต้องการถอดเปลี่ยนหัวต่ออย่างรวดเร็ว ถูกนำมาใช้งานสำหรับสายใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดียวและชนิดหลายโหมดมากที่สุด โดยที่หัวต่อ ประเภทนี้มีอัตราการสูญเสียกำลังแสงเพียงแค่ไม่เกิน 0.5 dB เท่านั้น วิธีการเชื่อมต่อก็เพียงสอดเข้า ไปที่รูหัวต่อแล้วบิดตัวเพื่อให้เกิดการล็อก จึงเพิ่มความทนทานทำให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากการ สั่นสะเทือน ปัจจุบันถูกนำมาใช้กับระบบ LAN ในอาคารสำนักงาน (Indoor fiber optic)

#### 3. หัวต่อแบบเอสซี (SC Connector)

หัวต่อชนิดนี้ได้รับการออกแบบครั้งแรกโดยบริษัท เอ็นทีที (NTT) แห่งญี่ปุ่น หัวต่อชนิด นี้ใช้งานง่ายเพียงดันหัวต่อเข้าไปก็ใช้งานได้แล้ว หัวต่อชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาใช้แทนหัวต่อแบบเอฟ ซีในงานด้านสื่อสาร และหัวต่อเอสทีในงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วย จึงใช้งานได้หลากหลาย ข้อดีของหัวต่อชนิดนี้คือรูสอดของเส้นใยนำแสงมีขนาดพอดีกับความโตของเส้นใยนำแสง มีวิธีการ ผลิตที่ละเอียดอ่อนเที่ยงตรง การลดทอนสัญญาณเส้นใยนำแสงแบบโหมดเดียวมีค่าประมาณ 0.25 dB และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 0-0.6 dB ขณะที่เอาหัวต่อเสียบต่อกัน หัวต่อแบบเอสซี เป็นของใหม่เพิ่งนำออกมาวางตลาดในอเมริกา มีใช้ประมาณ 1% ของที่ติดตั้งทั้งหมด แต่ขณะนี้ได้รับ ความนิยมมากขึ้นเนื่องจากใช้งานง่าย เป็นแบบถอดเข้าออกได้ และในขณะที่เอาหัวต่อกันก็ไม่ต้อง หมุนหรือบิด แต่ใช้การเสียบต่อตรง ๆ นอกจากนี้หัวต่อแบบเอสซียังเป็นชนิดปรับแกนเส้นใยนำแสง ได้ด้วย

#### 4. หัวต่อแบบแอลซี (LC Connector)

หัวต่อแบบนี้เป็นหัวเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย สะดวก ราคาไม่แพง มีทั้งแบบโหมดเดียวและ แบบหลายโหมด มักใช้ในการรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงมากเช่น GBIC, Gigabit Speed Fast Ethernet Converter หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางแสง (Optical module) ภายในองค์กร มีขนาดหน้า ตัด 9/125

#### 5. หัวต่อแบบเอฟดีดีไอ (FDDI <mark>Co</mark>nnector)

ออกแบบโดย American National Standards Institute (ANSI) สำหรับใช้งานบน เครือข่าย FDDI โดยเฉพาะ

### 4.2 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับตัวขับเร้า<mark>ทาง</mark>ไฟฟ้าสถ<mark>ิตแล</mark>ะแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นระบบกลไฟฟ้าจุลภาคคือหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในสาย อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขึ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญและต้องการความแม่นยำในการทำงานสูง จึงได้มีการนำตัวขับเร้าจุลภาค (Microactuator) ใช้ในการขับเคลื่อนโครงสร้างต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การกระตุ้นตัวขับเร้าจุลภาค สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ฟิล์มเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric films), การใช้หลักการใน การขยายตัวของโลหะเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal expansion), การใช้หลักการของโลหะอัลลอยด์ ที่คืนรูปได้ (Shape memory alloy) และการใช้หลักการของไฟฟ้าสถิต (Electrostatic forces) เป็นต้น

โครงสร้างพื้นฐานที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงนั้น จะใช้ โครงสร้างตัวขับเร้าแบบไฟฟ้าสถิตที่อาศัยแรงทางไฟฟ้าสถิตในการขับเคลื่อนโครงสร้าง การที่จะหา แรงทางไฟฟ้าฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นนั้น จะเริ่มโดยอ้างอิงจากกฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law) คือ ขนาด ของแรงที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับผลคูณของประจุทั้งสอง และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง ระหว่างประจุทั้งสอง, ประจุชนิดเดียวกันแรงที่เกิดขึ้นคือแรงผลัก ประจุต่างชนิดกันแรงที่เกิดขึ้นคือ แรงดึงดูด และทิศของแรงอยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุทั้งสอง ดังนั้นแรงที่กระทำระหว่าง ประจุสองประจุในอากาศว่างจึงเป็นดังสมการดังสมการที่ 4.1

$$F_e = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R^2} \tag{N}$$

โดยที่  $F_{e}$  คือ แรงไฟฟ้าสถิต มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)

- ${\it Q}_{\rm l}$  ,  ${\it Q}_{\rm 2}$  คือ ประจุไฟฟ้าแบบจุด มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ (C)
- R คือ ระยะทางระหว่างประจุ  $Q_1$  และ  $Q_2$
- $arepsilon_0$  คือ ค่า permittivity ของสุญญากาศ มีค่าเท่ากับ 8.85 imes 10<sup>-12</sup> F/m
- *ɛ*, คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง

ในตัวขับเร้าแบบไฟฟ้าสถิตนั้น แรงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในลักษณะแรงไฟฟ้าสถิตของแผ่นตัวนำสอง แผ่นวางขนานกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.8 โดยมีแผ่นตัวนำที่มีพื้นที่ *A* วางห่างกันสม่ำเสมอด้วย ระยะทาง *d* และมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์อยู่ระหว่<mark>า</mark>งแผ่นตัวนำทั้งสอง



<mark>รูปที่ 4.8 ลักษณะของแผ่นตัวนำคู่ขน</mark>าน

4.2.1 ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี (Electrostatic comb-drive actuator)

ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ตัวขับเร้าแบบซี่หวี โครงสร้างจะ ประกอบไปด้วยซี่หวีหลายคู่ (Toshiki Hirano, 1992) ซึ่งแต่ละคู่ของซี่หวีจะอยู่ในลักษณะของแผ่น ตัวนำคู่ขนาน มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ โดยส่วนที่เคลื่อนที่ นั้นจะมีสปริงติดอยู่ด้วย ดังรูปที่ 4.9 ลักษณะการขับของตัวขับเร้าแบบซี่หวีจะใช้หลักการของไฟฟ้า สถิต เมื่อมีการป้อนไฟฟ้าให้กับระบบ ส่วนที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนเข้าหาส่วนคงที่ และเมื่อตัดไฟฟ้าออก สปริงจะทำหน้าที่ดึงส่วนที่เคลื่อนที่ได้กลับมายังจุดเดิม



รูปที่ 4.9 โครงส<mark>ร้า</mark>งของตัวขับเร้าแบบซี่หวี

ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวีจะสามารถทำงานได้เมื่อทำการป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้า กับขั้วของส่วนที่อยู่กับที่ (Fixed) และต่อกราวด์เข้ากับขั้วของส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Movable) ซึ่งจะทำ ให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองและจะกลายเป็นประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าสถิตขึ้น ในทิศทางแนวแกน x ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 โมเดลของตัวขับเร้าแบบซี่หวี

แรงไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างซี่หวีนั้น สามารถอธิบายได้ดังสมการที่ 4.2

$$F_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{Nt\varepsilon_0 \varepsilon_r V^2}{g} \tag{N}$$

โดยที่  $F_e$  คือ แรงไฟฟ้าสถิต มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)

- N คือ จำนวนซี่ของตัวขับเร้า
- *t* คือ ความหนาของขั้วไฟฟ้า
- $\mathcal{E}_0$  คือ ค่า permittivity สัมบูรณ์ มีค่าคงที่เท่ากับ 8.85 imes 10<sup>-12</sup> F/m
- $\varepsilon_r$  คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง
- V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อน
- g คือ ขนาดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว

การเคลื่อนที่ของตัวขับเร้า ในส่วนที่เคลื่อนที่ได้จะถูกทำให้ลอยอยู่ในอากาศโดยมีคาน ซึ่งทำหน้าที่ค้ำยันให้โครงสร้างลอยตัวได้ ทั้งยังทำหน้าที่เหมือนสปริงคอยดึงส่วนที่เคลื่อนที่ได้ให้ กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อหยุดการกระตุ้นตัวขับเร้า พิจารณาส่วนของสปริงในโครงสร้าง จากรูปที่ 4.11 สปริงเป็นแบบ fixed-fixed beams และแรงที่กระทำกับสปริงจะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางคาน พอดี



รูปที่ 4.11 ลักษณะแรงที่เกิดบนคานสปริงแบบ fixed-fixed beam

อ้างอิงจากกฎของฮุค (Hooke's law) ค่าแรงในการดึงกลับของสปริงสามารถคิดได้จาก ค่า stiffness ของคานที่ทำหน้าที่เป็นสปริงดังกล่าว และสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ดัง สมการที่ 4.3

$$F_s = k \cdot x \tag{(N)}$$

โดยที่ *F*, คือ แรงปฏิกิริยาหรือแรงดึงกลับของสปริง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)

- k คือ ค่าคงที่สปริง (spring stiffness)
- *x* คือ ระยะของการเคลื่อนที่

โดยคานที่ค้ำให้โครงสร้างลอยตัวอยู่บนอากาศนั้น ต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะทำให้ โครงสร้างสามารถเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องการได้ หากคานมีความยืดหยุ่นน้อยหรือแข็งมากไป จะยิ่ง ทำให้ต้องใช้แรงอย่างมากในการทำให้โครงสร้างนั้นเคลื่อนที่ และจะส่งผลให้ต้องป้อนแรงดันให้กับตัว ขับเร้ามากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการออกแบบลักษณะของคานสปริงดังกล่าวจึงมีความสำคัญ (Gabriel M. Rebeize, 2003) ในการออกแบบตัวขับเร้าแบบซี่หวีจะมีคานสปริงที่นิยมใช้อยู่ 3 แบบ ได้แก่ คานสปริงแบบ fixed-fixed beams ดังรูปที่ 4.12, คานสปริงแบบ folded beam ดังรูปที่ 4.13 และคานสปริงแบบ serpentine beam ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.12 คานสปริงแบบ fixed-fixed beams

ซึ่งสามารถหาค่าคงที่สปร<mark>ิงของ</mark>คานแบบ fixed-fixed beams ได้จากสมการที่ 4.4

 $k = 4Ew\left(\frac{t}{l}\right)^3$ 

(4.4)

- โดยที่ *k* คือ ค่าคงที่สปริงมี หน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m)
  - E คือ ค่าความยึดหยุ่นของวัสดุ (Young's modulus)
  - พ คือ ความกว้างของสปริง
  - t คือ ความสูงของสปริง
  - *l* คือ ความยาวของสปริง



รูปที่ 4.13 คานสปริงแบบ folded beam

ซึ่งสามารถหาค่าคงที่สปริงของคานแบบ folded beam ได้จากสมการที่ 4.5

$$k \approx 2Ew \left(\frac{t}{l}\right)^3$$
 (N/m) (4.5)

โดยที่ k คือ ค่าคงที่สปริง หน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m)

E คือ ค่าความยึดหยุ่นของวั<mark>สดุ (</mark>Young's <mark>mo</mark>dulus)

พ คือ ความกว้างของสปริง

t คือ ความสูงของสปริง

1 คือ ความยาวของสปริง



รูปที่ 4.14 คานสปริงแบบ serpentine beam

ซึ่งสามารถหาค่าคงที่สปริงของคานแบบ serpentine beam ได้จากสมการที่ 4.6

$$k \approx \frac{48GJ}{l_a^2 \left(\frac{GJ}{El_x} l_a + l_b\right) n^3}$$
(N/m) (4.6)

โดยที่ *k* คือ ค่าคงที่สปริง หน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m)

- G คือ ค่ามอดูลัสของการบิด (Torsion modulus)
- J คือ ค่าคงที่ของการบิด (Torsion constant)
- คือ ความกว้างของสปริง  $l_a$
- *l*, คือ ความยาวของสปริง
- E คือ ค่าความยืดหยุ่นของวัสดุ (Young's modulus)
- $I_x$  คือ โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of inertia) ของสปริง
- คือ จำนวนขดของสปริง п

โดยสามารถหาค่ามอดูลัสของการบิดได้จากส<mark>มก</mark>ารที่ 4.7

$$G = \frac{E}{2(1+\vartheta)} \tag{4.7}$$

- โดยที่ E คือ ค่าความยืดหยุ่นของวั<mark>สดุ</mark> (Young's <mark>mo</mark>dulus)
  - 9 คือ ค่าอัตราส่วนของ<mark>ปัวซ</mark>อง (Poisson's ratio)

สามารถหาโมเมนต์ความเฉื่อยของสปริงได้จากสมการที่ 4.8

$$\frac{wt^3}{12} \tag{4.8}$$

โดยที่  $I_x$  คือ โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of inertia) ของสปริง

- พ คือ ความกว้างของสปริง
- าคโนโลยีสุร<sup>ูง</sup> t คือ ความสูงของสปริง

และสามารถหาค่าคงที่ของการบิดได้จากสมการที่ 4.9

$$J = \frac{1}{3}t^{3}w \left(1 - \frac{192}{\pi^{5}}\frac{t}{w}\sum_{i=1,iodd}^{\infty}\frac{1}{i^{5}}\tanh\left(\frac{i\pi w}{2t}\right)\right)$$
(4.9)

ในสภาพสมดุล แรง  $F_{_e}$  และแรง  $F_{_s}$  จะมีค่าเท่ากัน ซึ่งการเคลื่อนที่ในแนวแกน imesสามารถอธิบายได้ดังสมการที่ 4.10

 $I_x =$ 

$$x = \frac{F_s}{k_x} \tag{m}$$

$$x = \frac{Nt\varepsilon_0\varepsilon_r V^2}{gk_x}$$
 (m) (4.10)

หรือสามารถหาแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ป้อนให้ตัวขับเร้าได้จากสมการที่ 4.11

$$V^{2} = \frac{xgk_{x}}{Nt\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}} \qquad (\lor)$$

์ โดยที่  $\,V\,$  คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อน <mark>มีหน่วยเ</mark>ป็น โวลต์ (V)

- *x* คือ ระยะของการเคลื่อนที่
- g คือ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว
- $k_x$  คือ ค่าคงที่สปริงที่จำนวนขดของสปริงเพิ่มขึ้นในแนวแกน imes
- N คือ จำนวนซี่ที่เคลื่อนที่ของตัวขับเร้า
- t คือ ความสูงของขั้วไฟฟ้า
- $arepsilon_0$  คือ ค่า permittivity สัมบูรณ์ มีค่าเท่ากับ 8.85  $imes 10^{-12}$  F/m
- E, คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง

จากสมการที่ 4.11 ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อออกแบบตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต ให้ เป็นตัวขับเร้าแบบซี่หวีและมีคานสปริงแบบ serpentine beam แล้วกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้คงที่ ๆ ค่า ๆ หนึ่ง การเพิ่มจำนวนของซี่หวีนั้นจะทำให้สามารถลดค่าแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อน (driving voltage) ที่ต้องป้อนให้กับตัวขับเร้าได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 แรงดันไฟฟ้า<mark>ขับเ</mark>คลื่อนที่ต้องป้อนใ<mark>ห้ตัว</mark>ขับเร้าเมื่อเทียบกับจำนวนซี่หวี

ในกรณีของรูปที่ 4.15 นั้น ใช้แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนในการป้อนให้กับอุปกรณ์เพียง 80 V ก็จะสามารถทำให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางถึง 100 µm หากเพิ่มจำนวนซี่หวีในการ ออกแบบให้มีจำนวน 100 ซี่

เช่นเดียวกัน จากสมการที่ 4.11 จะเห็นว่า หากลดขนาดของระยะห่างระหว่างซี่หวีแต่ ละซี่ให้ยิ่งน้อยลง ก็จะสามารถลดแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้องป้อนให้กับตัวขับเร้าได้น้อยลงไปด้วย ดังแสดงได้ในรูปที่ 4.16 ซึ่งในกรณีนี้ อาจมีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบ รวมถึงกระบวนการในการ สร้างตัวขับเร้าเองก็มีส่วนในการกำหนดขนาดของช่องว่างที่น้อยสุดที่สามารถสร้างได้ด้วย



รูปที่ 4.16 แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ต้องป้อนให้ตัวขับเร้าเมื่อเทียบกับ ระยะห่างระหว่างซี่หวีทั้งสองขั้ว

จากรูปที่ 4.16 นั้นจะเห็นว่า ใช้แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนในการป้อนให้กับอุปกรณ์เพียง 65 V ก็จะสามารถทำให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางถึง 100 µm หากลดระยะห่างระหว่างซี่หวีในการ ออกแบบให้เหลือเพียง 50 µm

เนื่องจากในการสร้างตัวขับเร้าด้วยกระบวนการเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีที่พัฒนาขึ้นใน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นั้น สามารถสร้างโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 500 μm ได้ โดยใช้สารไวแสง SU-8 คู่กับการฉายรังสีเอกซ์ ณ BL6 ของสถาบันวิจัย ซึ่งจะทำให้ สามารถเพิ่มความสูงของซี่หวีของตัวขับเร้าขึ้นได้ โดยรูปที่ 4.17 จะแสดงการเปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ป้อนให้กับตัวขับเร้า เมื่อเทียบกับความสูงของซี่หวีที่เปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 4.17 แรงดันไฟฟ้าขับ<mark>เคลื่อนที่ต้องป้อนให้ตัว</mark>ขับเร้<mark>าเมื่อ</mark>เทียบกับความสูงของซี่หวี

จากรูปที่ 4.17 จะเห็นว่า ใช้แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนในการป้อนให้กับอุปกรณ์เพียง 60 V ก็จะสามารถทำให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางถึง 100 μm หากเพิ่มความสูงของซี่หวีในการออกแบบ ให้มีค่า 500 μm

และจากสมการที่ 4.11 เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าเมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ค่าต่าง ๆ ให้ คงที่ ๆ ค่า ๆ หนึ่ง หากต้องการให้ซี่หวีมีระยะการเคลื่อนที่ ๆ มากขึ้น ก็จะต้องเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ขับเคลื่อนที่ป้อนให้กับตัวขับเร้าให้สูงขึ้นตามไปด้วย ดังแสดงได้ในรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 แรงดันไฟ<mark>ฟ้า</mark>ขับเ<mark>คลื่อนที่ต้องป้อนให้ตัวขับ</mark>เร้าเมื่<mark>อ</mark>เทียบกับระยะที่ซี่หวีเคลื่อนที่

จากรูปที่ 4.<mark>18 จะ</mark>เห็นว่าใช้แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนในการป้อนให้กับอุปกรณ์ 100 V จะ สามารถทำให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้<mark>ระยะทางถึง 200 µm เลยทีเดี</mark>ยว

4.2.2 ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน (Electrostatic parallel plate actuator)

ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน เป็นตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตอีกชนิดหนึ่งที่มี การใช้กันอย่างแพร่หลาย (Gregory N. Nielson, 2006) มีโครงสร้างและหลักการทำงานคล้ายกับตัว ขับเร้าแบบซี่หวี นั่นก็คือมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยส่วนที่เคลื่อนที่ได้นั้นจะมีสปริงติดอยู่ด้วย ดังรูปที่ 4.19 ลักษณะการขับของตัวขับเร้าแบบแผ่น คู่ขนานนี้ก็จะใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกับตัวขับเร้าแบบซี่หวี เมื่อมีการป้อนไฟฟ้าให้กับ ระบบ ส่วนที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนเข้าหาส่วนคงที่ และเมื่อตัดไฟฟ้าออก สปริงจะทำหน้าที่ดึงส่วนที่ เคลื่อนที่ได้กลับมายังจุดเดิม



รูปที่ 4.19 ลักษณะโครง<mark>สร้</mark>างของตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนาน

เมื่อทำการป้อนแรงดันไฟฟ้า<mark>เข้ากับข</mark>ั้วของส่วนที่อยู่กับที่ (fixed) และต่อกราวด์เข้ากับ ขั้วของส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (movable) ซึ่ง<mark>จ</mark>ะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสอง และจะ



กลายเป็นประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าสถิตขึ้นในทิศทางแนวแกน × ดังรูปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 โมเดลของตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนาน

กรณีนี้ประจุบนแผ่นตัวเก็บประจุคือ

$$Q = V \cdot C = \frac{V\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{g} \tag{4.12}$$

ในกรณีนี้แรงไฟฟ้าสถิต ( $F_e$ ) ที่เกิดขึ้นบนแผ่นตัวเก็บประจุจะเท่ากับแรงสปริง ( $F_s$ )

$$F_e = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon_r A} = \frac{V^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r A}{2g^2} = k \cdot x = F_s \qquad (N) \qquad (4.13)$$

เราจะเห็นว่า *x* เป็นฟังก์ชันของระยะห่างร<mark>ะห</mark>ว่างแผ่น นั่นคือ

$$g = g_0 - x \tag{4.14}$$

ดำเนินการแก้สมการหาแรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนจะได้

$$V = \sqrt{\frac{2kx}{NA\varepsilon_0\varepsilon_r}}(g_0 - x) \qquad (\forall) \qquad (4.15)$$

โดยที่ V คือ ค่าแรงดันไ<mark>ฟฟ้าขับเคลื่อน มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)</mark>

- k คือ ค่าคงที่สปริง (spring stiffness)
- $arepsilon_0$ คือ ค่า permittivity สัมบูรณ์ มีค่าเท่ากับ 8.85 × 10<sup>-12</sup> F/m
- *ɛ*, คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง
- A คือ พื้นที่ผิวบริเวณที่เกิดประจุไฟฟ้า
- N คือ จำนวนแผ่นตัวนำที่เคลื่อนที่ของตัวขับเร้า
- g<sub>0</sub> คือ ระยะห่างเริ่มต้นระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว
- *x* คือ ระยะที่แผ่นตัวนำเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ของตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนานจะมีหลักการทำงานคล้ายกันกับตัวขับเร้า แบบซี่หวี คือในส่วนที่เคลื่อนที่ได้จะถูกทำให้ลอยอยู่ในอากาศ โดยมีคานซึ่งทำหน้าที่ค้ำยันให้ โครงสร้างลอยตัวได้ ทั้งยังทำหน้าที่เหมือนสปริงคอยดึงส่วนที่เคลื่อนที่ได้ให้กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้น เมื่อหยุดการกระตุ้นตัวขับเร้า

เมื่อ k เป็นค่าคงที่สปริงของระบบ จะมีตำแหน่ง 2 ตำแหน่งที่แรงไฟฟ้าสถิตเท่ากับ elastic restoring force ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าคงที่ (stiffness) ของสปริง, ระยะห่างระหว่างแผ่นเริ่มต้น และความเข้มสนามไฟฟ้า โดยที่ตำแหน่งแรกจะอยู่ในตำแหน่งสมดุลที่มีเสถียรภาพ ซึ่งแผ่นตัวนำ ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้จะสามารถคืนตัวกลับเมื่อเคลื่อนที่หรือถูกดึงไปเล็กน้อย ในขณะที่ตำแหน่งที่สอง เป็นสมดุลที่ไม่มีเสถียรภาพ คือเมื่อความเข้มสนามไฟฟ้ามากขึ้นเพียงเล็กน้อยจะทำให้แผ่นตัวนำไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ได้ถูกดึงลงมาติดกับฐานทันที เรียกลักษณะการเกิดปรากฏการณ์นี้ว่า pull-in ซึ่งสามารถ หาแรงดันไฟฟ้าแนบติด (pull-in voltage) ได้<mark>จา</mark>กสมการ

$$V_{pi} = \sqrt{\frac{8kg_0^3}{27\varepsilon_0\varepsilon_r NA}} \qquad (\vee) \qquad (4.16)$$

ิโดยที่ V<sub>pi</sub> คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าแน<mark>บติ</mark>ด มีหน่วยเป็นโวล<mark>ต์ (</mark>∨)

- k คือ ค่าคงที่สปริง
- g<sub>0</sub> คือ ระยะห่างเริ่มต้นระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว
- $arepsilon_0$ คือ ค่า permittivity สัมบูรณ์ มีค่าคงที่เท่ากับ 8.85 imes 10<sup>-12</sup> F/m
- E, คือ ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง
- N คือ จำนวนแผ่นตัวน้ำที่เคลื่อนที่ของตัวขับเร้า
- A คือ พื้นที่ผิวบริเวณ<mark>ที่เกิดประจุไฟฟ้า</mark>

จากสมการที่ 4.16 ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อออกแบบตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต ให้เป็นตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนานและมีคานสปริงแบบ serpentine beam แล้วกำหนด ค่าพารามิเตอร์ค่าต่างๆ ให้คงที่ ๆ ค่า ๆ หนึ่ง การเพิ่มจำนวนของแผ่นตัวนำนั้นจะทำให้แรงดันไฟฟ้า แนบติด ที่ทำให้แผ่นตัวนำทั้งสองถูกดึงมาชนกันมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 4.21 โดยหากระยะห่าง เริ่มต้นของแผ่นตัวนำทั้งสองมีค่า 120 µm และออกแบบตัวขับเร้าให้มีแผ่นตัวนำที่เคลื่อนที่ได้มี จำนวน 120 แผ่น แรงดันไฟฟ้าแนบติดที่จะทำให้แผ่นตัวนำถูกดึงมาชนกันจะมีค่า 60 V นั่นเอง



รูปที่ 4.21 แรงดันไฟฟ้า<mark>แน</mark>บติดที่เกิดขึ้นในตัวข<mark>ับเร</mark>้าเมื่อเทียบกับจำนวนแผ่นตัวนำ



#### 4.3 การออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

การออกแบบอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงในงานวิจัยนี้ได้คำนึงถึงขนาดโครงสร้าง วัสดุ กระบวน การสร้าง รวมถึงระยะเวลาในการสร้าง ให้สอดคล้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงในงานวิจัยนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ กระจกจุลภาค ทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางของแสง และตัวขับเร้าจุลภาคทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ กระจกจุลภาค ดังรูปที่ 4.22 และ 4.23



## รูป<mark>ที่</mark> 4.2<mark>2 โครงสร้างด้านบนของอุป</mark>กรณ์<mark>สวิต</mark>ช์เชิงแสง



รูปที่ 4.23 โครงสร้างสามมิติของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

# ตารางที่ 4.8 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

Parameter Symbol		Size	
Spring wide	W	50 µm	
Thickness	t	350 µm	
Gap distance	g	50 µm	
Length ( $^{a}$ )	$l_a$	500 μm	
Length ( $^{b}$ )	$l_b$	3000 μm	
Number of meander	n	12	
Comb wide	b	50 µm	
Number of moving comb or plate	Ν	128	
Spring constant	k	-	
Torsion modulus	G	-	
Torsion constant	J	-	
Moment of inertia	$I_x$	-	
Young's modulus	E	2 GPa	
Moving distance	x	100 µm	
Poisson's ratio	9	0.22	
Mirror wide neral	แทคโพ็ลยีสุร	30 µm	
Length of mirror	$l_m$	200 µm	
Groove of optical fiber	W <sub>f</sub>	130 µm	
Starting gab of plate	<i>g</i> <sub>0</sub>	120 μm	





ร<mark>ูปที่</mark> 4.2<mark>4 ขนาดพารามิเตอร์ของอุป</mark>กรณ์<mark>สวิต</mark>ช์เชิงแสง

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงโดยทั่วไปจะมีขนาดของ ระยะห่างระหว่างโครงสร้างที่เล็กที่สุดอยู่ในช่วง 1-10 µm อันเนื่องมาจากมีกระบวนการสร้างฟิล์มที่ สามารถวาดลวดลายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถสกัดเนื้อวัสดุเพื่อขึ้น รูปหรือทำลวดลายให้มีความเที่ยงตรง นั่นก็หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างซิ้นงานก็ต้องสูงตามไป ด้วย การออกแบบขนาดโครงสร้างต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดทางด้านการสร้างฟิล์มต้นแบบ สำหรับเป็นหน้ากากกั้นแสง ซึ่งขนาดโครงสร้างที่เล็กที่สุดที่มีความแม่นยำและสามารถสร้างได้นั้นจะ อยู่ในช่วง 30-35 µm ทำให้อุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงที่จะออกแบบต้องปรับขนาดโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้น โดยมีโครงสร้างส่วนที่เล็กหรือแคบที่สุดอยู่ในช่วง 30-35 µm และเมื่อโครงสร้างมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างให้สูงขึ้นตามไปด้วยด้วย เพื่อเป็นการชดเชยระยะห่างระหว่าง โครงสร้าง เนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องของแรงขับเคลื่อน (Driving force) เพราะหากซี่หวีอยู่ห่างกัน เกินไป จะทำให้ต้องใช้แรงในการขับเคลื่อนมาก หมายถึงต้องสามารถหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง มากพอตัวขับเร้าจึงจะเกิดการเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนสำหรับซื้อแหล่งจ่ายดังกล่าว และสิ่ง สำคัญอีกประการหนึ่งคืออันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าแรงสูงต่อผู้ทดลองเอง อีกทั้งอุปกรณ์อาจจะได้รับ ความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องทำการชดเชยโครงสร้างของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงด้วยการสร้างโครงสร้าง ให้มีความสูงมากกว่าความกว้าง เรียกว่า กระบวนการสร้างโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนสูง (High aspect ratio micromachining) ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์ เนื่องจากรังสีเอกซ์มี พลังงานสูงทำให้โครงสร้างที่ได้มีผนังตั้งฉากกับฐานรองและเรียบคม และอีกเหตุผลที่โครงสร้างของ อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงมีขนาดใหญ่คือ ปัจจุบันกระบวนการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังอยู่ ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถสร้าง ได้ง่ายกว่าโครงสร้างขนาดเล็ก เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานสำหรับการรองรับการสร้างอุปกรณ์ที่ต้องการโครงสร้างที่ขนาด เล็กต่อไป



# บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

หลังจากได้ศึกษากระบวนการพื้นฐานจากบทที่ 3 และ ในบทที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ออกแบบอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงพร้อมกับได้ทำการจำลองระบบพลวัต ในบทนี้จะนำเสนอการผลิต การ พัฒนา และการแก้ปัญหาระหว่างการสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงด้วยเทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้า จุลภาค โดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กลไฟฟ้าจุลภาค

#### 5.1 การสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

ในงานวิจัยนี้ได้มีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงขึ้นหลากหลายรูปแบบ มีทั้งการ ปรับเปลี่ยนชนิดของตัวขับเร้า เพิ่มลดขนาดของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนลักษณะการวางตัว ของสปริง ตลอดจนเพิ่มลดจำนวนขดของสปริงเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีโครงสร้างที่ เหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

อุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงของงานวิจัยนี้ จะมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสารไวแสงแบบลบ SU-8 ที่ผ่านกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์จนเกิดลวดลายเป็นโครงสร้างอยู่บนแผ่นกราไฟต์ จากนั้นทำการเคลือบโลหะโครเมียมและทองคำเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวเกิดการนำไฟฟ้าและสามารถ สะท้อนแสงได้ การสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ รูปที่ 5.1





รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

สำหรับขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง สามารถอธิบายได้โดยละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ยึดแผ่นกราไฟต์กับกระจกด้วยเทปกันความร้อน แล้วทำความสะอาดแผ่นกราไฟต์โดยการ เช็ดด้วยสำลีซุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ จากนั้นเช็ดด้วยสำลีอีกครั้ง หลังจากนั้นเป่าด้วยแก๊ส ในโตรเจน แล้วนำไปวางบนแผ่นความร้อนเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะทำการเคลือบสารไวแสงชนิดลบ SU-8 เบอร์ 2100 ด้วยการหยดสารไวแสงลงบน ฐานรองกราไฟต์ที่ยังวางอยู่บนแผ่นความร้อนดังกล่าว จนได้ความหนาของสารไวแสงประมาณ 300-400 μm จากนั้นให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วจึง ปิดสวิตช์แผ่นความร้อนและปล่อยให้ชิ้นงานค่อย ๆ เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส อีก 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาวัดความหนาอีกครั้งหนึ่งด้วยดิจิตอลไมโครมิเตอร์ ถ้า สารไวแสงที่ได้มีความหนามากเกินไปให้ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 1200 และ 3000 ขัด ตามลำดับจนได้ความหนาตามที่ต้องการ แล้วจะได้ฐานรองสำหรับสร้างโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิง แสง ดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 สารไวแสงบนฐานรองกราไฟต์สำหรับสร้างโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

2. นำสารไวแสงที่ได้จากข้อ 1 มาฉายรังสีเอกซ์ผ่านหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ ที่กระแสลำอิเล็กตรอน
 116.185 mA จนได้พลังงานสะสม 28000 mJ/cm<sup>3</sup> (Acc.BottomBright) ซึ่งจะใช้เวลาในการ
 ผอาบรังสีเอกซ์ 10 นาที ดังรูปที่ 5.3 จากนั้นนำชิ้นงานดังกล่าวมาวางบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิ
 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้สารไวแสงบริเวณที่ทำปฏิกิริยากับแสงแข็งตัว

maration MINU	1	aultor	Status		
HARTY SCAN STOT	Scanning Llose (mJ)(m1) Scan Tep lingt 24/777 Scan Tep Earl 0.202399 Scan Schwei Kills Wilcold from Tenton Territ 0.101007	Imilianter         4         Expressioner         22           Transform forming         0         Expressioner         22           Texcharmingtom         22.22         Expressioner         23			
	Act tige Highls (1977-35) Act tige Highls (1973-35) Act tige bar (1970-37) Act tige bar (1970-37) Act temps bar (1970-37) Act temps bar (1970-37) Starring Function Sector Scring decs, Actimutes batter bright (2000/01/1974)	Trapit Quality Starring Longin Trapitation III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIII			nin, Bishar Sahara Bishar Sahara Jiti M7k
	Bright Hilter (6:23) 20 on 8: Suphis 2000 um 6:30 8:54 60 um 6:30 8:3450 um Dade Filter (6:253 um 9: Suphis 2000 um 6:30 um 6:30 4:314 10:00 um				
OPEN SEQUENC	ABS	Open sequences: 7V5 > 7V4 > 7V3 > 7V2 > 7V6 = 705 - 600 - 703 100 - 705 - 600 - 707 101 - 705 - 705 - 707 101 - 705 - 705 - 707 101 - 705 - 705 - 707 - 707 101 - 705 - 705 - 707 - 707 - 707 101 - 705 - 705 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 101 - 705 - 705 - 707 - 70	5 × A35	л жал жанда	
	227.780	Used the USed the 120-2 the			
	0185 0784 0794 <sup>+</sup> 0784 <sup>+</sup> A45 85 942 1942	0194 (196) 2019 (196)			tara s

รูปที่ 5<mark>.3</mark> ฉายรังสีเอกซ์

 ล้างสารไวแสงในส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแสงโดยการแช่ลงไปในสารละลาย SU-8 developer เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นให้ฉีดล้างชิ้นงานด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าไม่มีสารไวแสงในส่วนที่ไม่ต้องการตกค้างอยู่ จากนั้นนำชิ้นงานที่ล้างสารไวแสงตกค้างออก หมดแล้วมาเป่าเบา ๆ ด้วยแก๊สไนโตรเจนจนแห้ง ก็จะได้โครงสร้างของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง ดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์

 4. นำโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์ มาทำการเคลือบโลหะโครเมียม ด้วยเครื่องสปัตเตอริงที่ความดัน 1.28x10<sup>-2</sup> torr, กำลัง 200 W และอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน 55 SCCM เป็นเวลา 9 นาที ซึ่งจะได้ความหนาของโครเมียม 0.25 μm หลังจากนั้นเคลือบโลหะ ทองคำทับบนโครเมียมด้วยเครื่องสปัตเตอริงที่ความดัน 1.56x10<sup>-2</sup> torr, กำลัง 150 W และอัตราการ ไหลของแก๊สอาร์กอน 65 SCCM เป็นเวลา 2 นาที ซึ่งจะได้ความหนาของทองคำ 0.1 μm ดังรูปที่ 5.5 เพื่อให้โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงดังกล่าวสามารถนำไฟฟ้าและสะท้อนแสงได้



รูปที่ 5.4 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ได้จากการฉายรังสีเอกซ์

5. หลอม SU-8 ผงแห้งบนโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ผ่านการเคลือบโลหะแล้ว ด้วย วิธีการเตรียมสารไวแสงแบบผงแห้ง ให้ได้ความหนาประมาณ 500 µm ซึ่งจะได้โครงสร้างอุปกรณ์ สวิตซ์เชิงแสงที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสงแล้ว ดังรูปที่ 5.6



รูปที่ 5.6 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ถูกเคลือบด้วยสารไวแสง

 ประกบสารไวแสงที่เคลือบโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงดังกล่าวกับกระจกให้แนบสนิทด้วย การให้ความร้อน หลังจากนั้นขัดกราไฟต์ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 และ 800 ตามลำดับ จนแผ่น กราไฟต์หลุดออกหมดและพื้นผิวโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงเรียบ ซึ่งจะได้ชิ้นงานตามรูปที่ 5.7



## รูปที่ 5.7 โครงส<mark>ร้าง</mark>อุปกรณ์สวิตช์เชิงแ<mark>สงก่</mark>อนและหลังขัดกราไฟต์

 7. เชื่อมต่อโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่ขัดกราไฟต์ออกแล้วลงบนฐานรองแผ่นวงจรพิมพ์ ด้วยกาวอีพ็อกซี (Epoxy) โดยผสมกาวอีพ็อกซีในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วทาโครงสร้างของอุปกรณ์สวิตช์ เชิงแสงบริเวณที่ต้องการให้ติดอยู่กับแผ่นวงจรพิมพ์ จากนั้นประกบโครงสร้างของชิ้นงานกับ แผ่นวงจรพิมพ์ดังกล่าวให้ลวดลายตรงกันที่สุด เสร็จแล้วปล่อยให้กาวแข็งตัว จะได้ชิ้นงานตามรูปที่ 5.8


รูปที่ 5.8 เชื่อมต่อโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแผ่นวงจรพิมพ์

8. ล้างสารไวแสงที่เคลือบอยู่บนโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงออกด้วยสารละลาย SU-8 developer จนสารไวแสงที่เคลือบอยู่หลุดออกจากโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงจนหมด (โดยใน ขั้นตอนนี้กระจกที่ติดอยู่กับสารไวแสงจะหลุดออกมาด้วย) รวมระยะเวลาการล้างสารไวแสงจนกระจก หลุดออกมาใช้เวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นฉีดล้างชิ้นงานด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบ สารไวแสงที่ตกค้างอยู่ จากนั้นเป่าแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน จะได้โครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่ติด อยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์ดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 โครงสร้างอ<mark>ุปก</mark>รณ์สวิตช์เ<mark>ชิงแ</mark>สงที่ติดอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์

หลังจากได้โครงสร้างของอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่สมบูรณ์แล้วได้ จึงนำโครงสร้างดังกล่าวไปวัด ขนาดจริงที่สร้างได้ด้วยกล้อง JEM 2010 light microscope ซึ่งจะได้ขนาดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดัง ตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ขนาดพารา<mark>มิเตอร์ของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ออกแบบ</mark> (ตามตารางที่ 4.8) และได้จากการสร้างจริง

พารามิเตอร์	W <sub>m</sub>	$l_m$	W <sub>f</sub>	l <sub>a</sub>	l <sub>b</sub> S	w	g	b	t
ออกแบบ (µm)	30	200	130	500	3000	50	50	50	350
สร้างจริง (µm)	22.91	197.36	131.79	494.27	2969.21	43.17	62.56	50.22	356

จากตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่าขนาดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ได้จากการออกแบบและจากการสร้าง โครงสร้างจริง มีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่าการสร้างโครงสร้างจากกระบวนการ เอกซ์เรย์ลิโธ กราฟฟี ทำให้ได้โครงสร้างที่มีขนาดใกล้เคียงกับการออกแบบสูงมากนั่นเอง



รูปที่ 5.10 ขนาดโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สร้างได้จริง

เมื่อได้ขนาดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สมบูรณ์แล้ว ต่อไปเป็นการจำลองการ ตอบสนองต่อแรงดันอินพุต โดยเปรียบเทียบการจำลองผลการตอบสนองระหว่างโครงสร้างที่ ออกแบบและโครงสร้างที่สร้างสำเร็จ ดังรูปที่ 5.11



รูปที่ 5.11 เปรียบเทียบผลการจำลองการตอบสนองของตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต

จากผลการจำลองพบว่า แรงดันขับเคลื่อนของตัวขับเร้าทั้งที่ได้จากการออกแบบ และที่ได้จาก การสร้างโครงสร้างจริงมีค่าต่างกันเล็กน้อย โดยหากต้องการให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางที่เท่ากัน แรงดันขับเคลื่อนที่ต้องป้อนให้กับโครงสร้างของตัวขับเร้าที่สร้างจริงจะมีค่าต่ำกว่าโครงสร้างตัวขับเร้า ที่ได้จากการออกแบบ จากรูปที่ 5.11 ถ้าต้องการให้ซี่หวีของตัวขับเร้าเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 200 µm โครงสร้างตัวขับเร้าที่ออกแบบจะต้องป้อนแรงดันขับเคลื่อน 100 V ส่วนโครงสร้างตัวขับเร้าที่สร้าง จริงจะต้องป้อนแรงดันขับเคลื่อน 90 V จึงจะเคลื่อนที่ได้ตามระยะที่กำหนด

## 5.2 รูปแบบของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีการสร้างขึ้นในงานวิจัย

หลังจากการนำเสนอโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีความสมบูรณ์ที่สุดไปแล้ว ในหัวข้อนี้จะ เป็นการนำเสนอลักษณะโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการออกแบบและสร้าง ขึ้นในงานวิจัยนี้



รูปที่ 5.12 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแ<mark>สงที่</mark>มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี มีคานสปริงแบบ fixed-fixed beam

จากรูปที่ 5.12 โครงสร้างของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงนี้จะมีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตเป็นแบบซี่หวี จะเห็นว่าจากลักษณะของโครงสร้างตัวขับเร้านั้นมีจำนวนซี่หวีน้อยมาก คือมีซี่หวีทั้งหมด 26 คู่ และมี สปริงเป็นแบบ fixed-fixed beam ซึ่งเมื่อนำมาขึ้นรูปโครงสร้างและทดสอบการทำงาน ผลปรากฏว่า ตัวขับเร้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากซี่ของตัวขับเร้ามีจำนวนน้อยเกินไป อีกทั้งสปริงก์มีความ ยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยนั่นเอง

อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงรูปแบบต่อมาเป็นอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตเป็น แบบซี่หวี และมีสปริงเป็นแบบ serpentine ซึ่งวางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค ดังรูปที่ 5.13 โดย โครงสร้างแบบนี้นั้นมีจำนวนซี่ตัวขับเร้าทั้งหมด 180 คู่ มีขนาดความกว้างของซี่ 30 µm มีขนาดของ ช่องว่างระหว่างซี่ 30 µm และมีสปริงทั้งหมด 6 ขด โดยที่สปริงส่วนบนกับส่วนล่างจะมีขนาดไม่ เท่ากัน เมื่อทำการสร้างและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบนี้ ผลปรากฏว่าตัวขับ เร้าสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเพียงเล็กน้อยก็เกินการลัดวงจรของซี่หวีซี่ที่อยู่ ติดกัน จึงไม่สามารถใช้งานได้



รูปที่ 5.13 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี และมีคานสปริงแบบ serpentine 8 ขด วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค

โครงสร้างแบบต่อมามีลักษณะตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตเป็นแบบซี่หวีเช่นกัน และมีสปริงเป็นแบบ serpentine ซึ่งวางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค โดยโครงสร้างแบบนี้มีจำนวนซี่หวีของตัวขับเร้าที่ สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 180 ซี่ มีขนาดความกว้างของซี่ 30 µm มีขนาดของช่องว่างระหว่างซี่ 30 µm และมีสปริงทั้งหมด 12 ขด ดังรูปที่ 5.14 สปริงส่วนบนกับส่วนล่างของโครงสร้างนี้มีขนาดไม่ เท่ากัน เมื่อทำการสร้างและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบนี้ ผลปรากฏว่าตัวขับ เร้าสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเพียงเล็กน้อยก็เกิดการลัดวงจรของซี่หวีซี่ที่อยู่ ติดกัน จึงไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับโครงสร้างในรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.14 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี และมีคานสปริงแบบ serpentine 12 ขด วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค จากปัญหาการเคลื่อนที่ที่ได้ระยะทางน้อยเกินไปของโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีตัวขับ เร้าแบบซี่หวีดังรูปที่ 5.13 และ 5.14 ทำให้ต้องออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงใหม่ โดย เปลี่ยนตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตจากแบบซี่หวีเป็นแบบแผ่นคู่ขนาน ซึ่งจากผลการจำลองทาง คณิตศาสตร์ของตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนานในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า ยิ่งตัวขับเร้ามีจำนวน แผ่นตัวนำที่เคลื่อนที่ได้มาก แรงดันไฟฟ้าแนบติดที่จะดึงให้แผ่นตัวนำเคลื่อนที่มาชนกันก็จะยิ่งต่ำ



รูปที่ 5.15 โครงสร้างอุปกรณ์<mark>สวิต</mark>ช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน และมีคานสปริงแบ<mark>บ s</mark>erpentine 12 ขด <mark>วางต</mark>ัวขนานกับกระจกจุลภาค

จากรูปที่ 5.15 ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตจะเป็นแบบแผ่นคู่ขนาน มีแผ่นตัวนำที่สามารถเคลื่อนที่ ได้จำนวน 112 แผ่น มีสปริงเป็นแบบ serpentine วางตัวขนานกับกระจกจุลภาคทั้งหมด 12 ขด โดยที่สปริงส่วนบนและส่วนล่างมีขนาดเท่ากัน เมื่อนำมาสร้างและทดสอบการทำงานผลปรากฏว่า ตัว ขับเร้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และโครงสร้างบริเวณแผ่นตัวนำมีการโก่งตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน เนื่องจาก โครงสร้างบริเวณดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่น

สำหรับโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าเป็นแบบแผ่นคู่ขนานที่มีการสร้างขึ้นใน งานวิจัยนี้อีกสองแบบก็คือ ตัวขับเร้าแบบแผ่นคู่ขนานที่มีแผ่นตัวนำ 120 คู่ โดยมีสปริงแบบ serpentine วางตัวขนานกับกระจกจุลภาค ดังรูป 5.16(ก) และอีกแบบหนึ่งคือ ตัวขับเร้าแบบแผ่น คู่ขนานที่มีแผ่นตัวนำ 120 คู่ โดยมีสปริงแบบ serpentine วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค ดังรูปที่ 5.16(ข) ซึ่งปัญหาของโครงสร้างแบบนี้ก็เหมือนกันกับโครงสร้างในรูป 5.15 นั่นคือ เกิดการโก่ง ตัวอย่างชัดเจนบริเวณโครงสร้างแผ่นตัวนำ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้



รูปที่ 5.16 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิ<mark>งแส</mark>งที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นคู่ขนาน และมีคานสป<mark>ริงแบบ</mark> serpentine 12 ขด

โครงสร้างแบบสุดท้ายที่มีการพัฒนาในงานวิจัยนี้คือ อุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทาง ไฟฟ้าสถิตเป็นแบบซี่หวีซึ่งมีซี่หวีที่เคลื่อนที่ได้ 128 ซี่ และมีสปริงแบบ serpentine 12 ขด วางตัวตั้ง ฉากกับกระจกจุลภาค ดังรูปที่ 5.17 เมื่อทำการทดสอบการทำงานของโครงสร้างแบบนี้ผลที่ได้คือ เมื่อทำการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวขับเร้า ตัวขับเร้าสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ แต่เมื่อหยุดป้อน แรงดันไฟฟ้า ตัวขับเร้าไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น เนื่องจากสปริงอาจมีความอ่อนตัวเกินไป



รูปที่ 5.17 โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวี และมีคานสปริงแบบ serpentine 12 ขด วางตัวตั้งฉากกับกระจกจุลภาค

เมื่อได้โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง โดยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดลองจะกล่าวถึงในบทต่อไป

## บทที่ 6

#### การทดสอบและผลการทดสอบ

หลังจากได้ทำการสร้างและพัฒนาโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงจนได้รูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งจำลองผลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของระบบ ต่อไปจะเป็นการนำเสนอวิธีการ ทดสอบอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่ได้จากการสร้าง โดยจะเริ่มต้นจากการการเชื่อมต่อสายไฟกับ โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงและแหล่งจ่ายแรงดันสูง จากนั้นป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ขั้วของตัวขับ เร้าเพื่อเป็นการกระตุ้นตัวขับเร้า แล้วปรับแรงดันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนตัวขับเร้าสามารถเคลื่อนที่ได้ ต่อจากนั้นจะเป็นการทดสอบการสวิตช์แสงจากกระจกจุลภาคของแสงที่เดินทางจากสายใยแก้วนำ แสงแบบโหมดเดียว

## 6.1 การเชื่อมสายอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

### 6.1.1 เชื่อมต่อตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตกับแหล่งจ่ายแรงดันสูง

เมื่อสร้างโครงสร้างอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงจนเสร็จสมบูรณ์ และนำโครงสร้างดังกล่าวยึด ติดบนแผ่นวงจรพิมพ์เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การเชื่อมต่อตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต กับแหล่งจ่ายแรงดันสูง เนื่องจากอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงที่สร้างขึ้นมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์เคลือบ โลหะนำไฟฟ้าและมีขนาดของจุดเชื่อมต่อค่อนข้างเล็ก หากจะทำการบัดกรีหรือใช้เครื่องเชื่อมสายมา เชื่อมต่อโดยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบาก อีกทั้งโครงสร้างยังไม่แข็งแรงนัก ดังนั้นการเชื่อมต่อตัว ขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตกับแหล่งจ่ายแรงดันสูงจึงต้องใช้การเชื่อมต่อสายทองแดงกับขั้วของตัวขับเร้าด้วย กาวนำไฟฟ้า

จากรูปที่ 6.1 มีการเชื่อมต่อสายทองแดงกับตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตอยู่ 4 จุด คือ จุดที่ เป็นโครงสร้างของตัวขับเร้าที่ลอยอยู่ในอากาศ 2 จุด กับจุดที่เป็นโครงสร้างของตัวขับเร้าที่ติดอยู่บน แผ่นวงจรพิมพ์ 2 จุด



รูปที่ 6.1 เชื่อมต่อสาย<mark>ทองแดง</mark>กับขั้วตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิต



รูปที่ 6.2 เชื่อมสายของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแหล่งจ่ายแรงดันสูง

รูปที่ 6.2 เป็นการแสดงภาพตัดขวางการเชื่อมต่อตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตกับแหล่งจ่าย แรงดันสูง โดยต่อไฟบวกเข้าที่ขั้วของตัวขับเร้าในส่วนที่ติดอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์ และต่อไฟลบเข้าที่ขั้ว ของตัวขับเร้าในส่วนที่ลอยอยู่ในอากาศ

## 6.1.2 เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงกับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงมีหน้าที่เปลี่ยนทิศทางของแสง ดังนั้นหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งของ อุปกรณ์นี้คือกระจกจุลภาค ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงที่เดินทางจากสายใยแก้วนำแสงเส้นหนึ่งด้วยมุม 90 องศา เพื่อไปเข้าสายใยแก้วนำแสงอีกเส้นหนึ่ง งานวิจัยนี้ได้ออกแบบให้มีร่องสำหรับวางสาย ้ใยแก้วนำแสงขึ้นด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางสายใยแก้วนำแสงให้วางทำมุมที่เหมาะสมกับ กระจกจุลภาค การวางสายใยแก้วนำแสงลงในร่องที่เตรียมไว้จะต้องอาศัยตัวเชื่อมต่อที่จะยึดให้สาย ้อยู่ในร่อง ดังรูปที่ 6.3 โดยในที่นี้จะใช้กาวอีพ็อกซีใสมาเป็นตัวเชื่อม เนื่องจากกาวอีพ็อกซีมีความ แข็งแรงแต่ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่ากาวชนิดอื่น อีกทั้งหาซื้อได้ง่าย



# รูปที่ 6.3 เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงกับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง 6.2 การทดสอบการเคลื่อนที่

การกระตุ้นอุปกรณ์ประเภทไฟฟ้าสถิตโดยทั่วไปแล้วจะใช้แรงดันสำหรับควบคุมที่มีค่าสูงแต่มี ้ค่ากระแสที่ต่ำ โดยมากอุปกรณ์ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นตัวเก็บประจุ การทดสอบการทำงานของ อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงจะเริ่มจากการป้อนแรงทางกล ด้วยการใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสะกิดที่ซี่หวีของ ้ตัวขับเร้าส่วนที่ลอยจากฐาน ให้เกิดการเคลื่อนไปมาเพื่อสังเกตดูว่าซี่หวีสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ไม่สัมผัสกับซี่หวีส่วนที่ติดกับฐาน ผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าซี่หวีของตัวขับเร้าของงานวิจัยนี้ สามารถขยับได้อย่างอิสระ จากนั้นทำการทดสอบขั้นที่สองด้วยการใช้แก๊สไนโตรเจนความดัน ประมาณ 1.5 psi เป่าบริเวณซี่หวีของตัวขับเร้าจนเกิดการเคลื่อนที่

วิธีต่อมาเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดคือ การป้อนแรงดันไฟฟ้าแก่ตัวขับเร้าเพื่อให้เกิดแรงไฟฟ้าสถิตที่ ซี่หวีของตัวขับเร้าจนเกิดการเคลื่อนที่ รูปที่ 6.4 เป็นการนำขนาดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ สวิตช์เชิงแสงที่สร้างขึ้นจริง มาจำลองหาผลตอบสนองการทำงานของตัวขับเร้า โดยจากกราฟจะเห็น ว่าเมื่อป้อนแรงดันขับเคลื่อน 65 V ซี่หวีของตัวขับเร้าจะเคลื่อนที่ได้ 100 μm



รูปที่ 6.4 ผลการจำล<mark>องการตอบสนองของโครงสร้างอุป</mark>กรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สร้างได้จริง

การควบคุมตัวขับเร้าในงานวิจัยนี้จะใช้สัญญาณพัลส์ที่มีแรงดัน 0 ถึง 200 V ความถี่ 0.5 Hz ป้อนให้กับอุปกรณ์ ซึ่งรูปที่ 6.5 เป็นแผนผังของวงจรขับและลักษณะสัญญาณพัลส์ที่เกิดจาก แหล่งจ่ายแรงดันสูง



รูปที่ 6.5 ชุดขับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงในงานวิจัย

ในการทดสอบจะทำการปรับค่าแรงดันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าตัวขับเร้าจะสามารถเคลื่อนที่ได้ ระยะทางที่ต้องการคือ 100 µm เมื่อปรับแรงดันเพิ่มขึ้นจนถึง 190 V พบว่าตัวขับเร้าสามารถ เคลื่อนที่ได้ตามระยะทางที่ต้องการ 100 µm



รูปที่ 6.6 <mark>ทดสอบการเคลื่อน</mark>ที่ของตัวขับเร<mark>้าทางไฟ</mark>ฟ้าสถิตแบบซี่หวี

10

โดยรูปที่ 6.6(ก) เป็นลักษณะการวางตัวของซี่หวีเมื่อไม่มีการป้อนแรงดันไฟฟ้า ซึ่งระยะห่างระหว่างซี่ หวีมีขนาด 120 μm และในรูปที่ 6.6(ข) เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของซี่หวีเมื่อมีการป้อนแรงดันไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า 190 V ระยะห่างระหว่างซี่หวีจะมีขนาดแคบลง โดยมีขนาดเหลือ เพียง 20 μm

เปรียบเทียบการจำลองผลตอบสนองทางคณิตศาสตร์ของโครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่สร้าง ขึ้นกับการทดสอบจริงพบว่า หากต้องการให้ซี่หวีเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 100 µm ผลการจำลองบอก ว่าต้องป้อนแรงดัน 65 V แต่ในการทดสอบจริงต้องป้อนแรงดันถึง 190 V ซึ่งมีค่าสูงกว่าผลการจำลอง ทางคณิตศาสตร์ 3 เท่า ซี่หวีของตัวขับเร้าจึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางที่กำหนด

#### 6.3 การทดสอบการสวิตช์แสง

ทดสอบการสวิตช์แสงด้วยกระจกจุลภาคของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงที่มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์เคลือบ โลหะทองคำ โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง (Lightwave multimeter) ยี่ห้อ HP รุ่น Hewlett Packard 8153A ความยาวคลื่น 1310 nm เริ่มต้นการทดลองโดยการวัดค่ากำลังของแสงที่เครื่องสามารถส่งได้ ด้วยการรับส่งแสงโดยตรงผ่านสายใยแก้วนำแสงเส้นเดียว ดังรูปที่ 6.7 ซึ่งสามารถวัดค่ากำลังแสงได้ 1.5 dBm



รูปที่ 6.7 <mark>วัดค่า</mark>กำลังของแสงที่ส่งออกมาจา<mark>กแหล่ง</mark>จ่ายสัญญาณแสง

10

ต่อจากนั้นเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงของอุปกรณ์สวิตซ์เชิงแสงกับแหล่งจ่ายสัญญาณแสง ดังรูปที่ 6.8 แล้วทดลองส่งสัญญาณแสงระหว่างสายใยแก้วนำแสงสองเส้นผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอากาศ ดังรูปที่ 6.9 และทำการวัดค่ากำลังของแสงที่สามารถรับส่งได้ ซึ่งจะได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 6.1



รูปที่ 6.8 เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงขอ<mark>งอุ</mark>ปกรณ์สวิตช์เชิงแสงกับแหล่งจ่ายสัญญาณแสง



รูปที่ 6.9 ทดสอบการรับส่งแสงผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอากาศ

1			· · ·	
a , ,	ר שי	י ו <i>י</i> ע	a 🧠 .	' ''
m 1 5 1 9 1 6 1	ดาการรบส	<u>(ທາງສາຄາປາຍເພປະ</u>	າລາ.ຫນາຍພລາຄາຜ	1891Del dRm
VII JINVI O.I	FI II I I I I I I I I I I I I I I I I I	INPPEINM I MAN 91		

Input Port	Output Port (dBm)						
	1	2	3	4			
1	-	-39.64	-11.17	-38.79			
2	-38.55	-	-38.55	-17.81			

Input Port	Output Port (dB)						
	1	2	3	4			
1	-	-41.14	-12.67	-40.29			
2	-40.05	-	-40.05	-19.32			

ตารางที่ 6.2 ค่าการสูญเสียของแสงเนื่องจากการส่งแสงผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศเทียบกับ การส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงโดยตรง หน่วย dB

จากตารางที่ 6.2 เมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1 ผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอากาศ พบว่าสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 3 สามารถวัดค่าแสงที่รับได้ดีที่สุด -11.17 dBm โดยคิดเป็นค่าการ สูญเสียของแสงเนื่องจากการส่งผ่านอากาศเมื่อเทียบกับการส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงโดยตรงได้ -12.67 dB และเมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 ผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอากาศนั้น พบว่าสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 4 สามารถวัดค่าของแสงที่รับได้ดีที่สุด -17.81 dBm คิดค่าการสูญเสีย ของแสงเนื่องจากการส่งผ่านอากาศเมื่อเทียบกับการส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงโดยตรงได้ -19.32 dB

ต่อมาเป็นการทดสอบการรับส่งแสงผ่านการสวิตช์แสงจากกระจกจุลภาค ดังรูปที่ 6.10 โดยให้ สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1 เป็นตัวส่งสัญญาณแสง และวัดค่าแสงที่รับได้ของสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2, 3 และ 4 จากนั้นให้สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 เป็นตัวส่งสัญญาณแสง และวัดค่าแสงที่รับได้ของ สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1, 3 และ 4 ตามลำดับ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็นเมื่อกระจกจุลภาคอยู่ ในสถานะเปิดและกระจกจุลภาคอยู่ในสถานะปิด ซึ่งจะได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 6.3



รูปที่ 6.10 ทดสอบการรับส่งแสงโดยการสะท้อนจากกระจกจุลภาค

	Output Port (dBm)							
Input Port	Switch on				Switch off			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	-	-38.42	-38.22	-22.22	-	-38.42	-11.17	-38.42
2	-38.30	-	-37.64	-38.73	-38.34	-	-38.44	-17.81

ตารางที่ 6.3 ค่าการรับส่งแสงผ่านการสะท้อนจากกระจกจุลภาค หน่วย dBm

ตารางที่ 6.4 ค่าการสูญเสียของแสงเนื่องจากการสะท้อนของกระจกจุลภาคเทียบกับ การส่งผ่านอากาศ หน่วย dB

	Output Port (dB)							
Input Port	Switch on				Switch off			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	-	-27.25	-27.05	-11.05	-	-27.25	0	-27.25
2	-20.49		-19.82	-20.92	-20.53	-	-20.63	0

จากตารางที่ 6.3 และ 6.4 จะเห็นว่าเมื่อกระจกจุลภาคอยู่ในสถานะเปิดคือมีกระจกจุลภาคเข้า ไปขวางทางเดินของแสง จะเห็นว่าเมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1 แล้วแสงเกิดการ สะท้อนจากกระจกจุลภาคพบว่าสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 4 สามารถวัดค่าของแสงที่รับได้ดีที่สุด -22.22 dBm โดยคิดค่าการสูญเสียของแสงเนื่องจากการสวิตช์จากกระจกจุลภาคเทียบกับการส่งผ่าน อากาศได้ -11.05 dB และเมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 แล้วแสงเกิดการ สะท้อนจากกระจกจุลภาคพบว่าไม่มีสายใยแก้วนำแสงที่สามารถรับแสงที่สะท้อนจากกระจกจุลภาค ได้เลย จากค่าการสูญเสียของแสงเนื่องจากการสวิตช์ของการรับส่งแสงระหว่างสายใยแก้วนำแสงเส้น ที่ 1 กับ 4 จะเห็นว่ามีค่าค่อนข้างสูง น่าจะมีสาเหตุมาจากผนังด้านข้างของกระจกจุลภาคบริเวณที่ เกิดการสะท้อนแสงมีผิวค่อนข้างขรุขระ ดังรูปที่ 6.11 จึงทำให้เมื่อแสงเดินทางมาตกกระทบที่ผิวของ กระจกจุลภาค มุมของแสงที่สะท้อนจากกระจกจุลภาคจึงอาจมีขนาดไม่ตรงกับ core ของสายใยแก้ว นำแสงเส้นที่ 4 จึงทำให้สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 4 รับแสงได้น้อยนั่นเอง



รูปที่ 6.11 พื้นผิวบริเว<mark>ณผ</mark>นังด้านข้างของกระจกจุลภาค

เมื่อกระจกจุลภาคอยู่ในสถานะปิดคือไม่มีกระจกจุลภาคขวางทางเดินของแสง พบว่า เมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1 สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 และ 4 ไม่สามารถรับ แสงได้เลย ส่วนสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 3 สามารถรับแสงได้เท่ากับกรณีที่ส่งแสงผ่านอากาศนั่นคือ -11.17 dBm และเมื่อส่งสัญญาณแสงจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 1 และ 3 ก็ไม่สามารถรับแสงได้เลย แต่สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 4 สามารถรับแสงได้เท่ากับกรณีที่ส่งแสงผ่าน อากาศซึ่งก็คือ -17.81 dBm

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของงานวิจัยนี้สามารถสวิตช์แสงได้เพียง ด้านเดียว เนื่องจากกระจกจุลภาคที่สร้างขึ้นมีขนาดความกว้างถึง 22.91 µm ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า core ของสายใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียว ที่มีขนาดเพียง 9 µm ทำให้เมื่อกระจกจุลภาคเคลื่อนที่ เข้าไปขวางทางเดินของแสง แสงที่เดินทางจากสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 2 แล้วสะท้อนกับกระจก จุลภาคจึงมีขนาดของมุมไม่ตรงกับ core ของสายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 3 ทำให้สายใยแก้วนำแสงเส้นที่ 3 ไม่สามารถรับแสงที่สะท้อนจากกระจกจุลภาคได้นั่นเอง

## 6.4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง

เนื่องจากกระจกจุลภาคของงานวิจัยนี้มีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถสวิตช์แสงพร้อมกันทั้งสอง ทางได้ ดังนั้นหากต้องการให้อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงแบบ 2x2 สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะต้องสร้างโครงสร้างของกระจกจุลภาคให้มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 10 μm อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง ก็จะสามารถสวิตช์แสงได้พร้อมทั้งสองทางได้ ดังรูปที่ 6.12 ซึ่งจะเห็นว่ากระจกจุลภาคมีขนาดความ กว้างน้อยกว่า core ของสายใยแก้วนำแสง ทำให้แสงที่สะท้อนจากกระจกจุลภาคมีขนาดของมุมที่ พอดีในการสวิตช์แสงพร้อมกันทั้งสองทาง



รูปที่ 6.12 โคร<mark>งสร้างกร</mark>ะจกจุลภาคที่เหมาะสม

และหากต้องการให้การสูญเสียข<mark>องแ</mark>สงเนื่องจ<mark>าก</mark>การสวิตช์มีค่าลดลง ก็ต้องสร้างกระจกจุลภาค ให้พื้นผิวของผนังด้านข้างบริเวณที่ใช้ใ<mark>นกา</mark>รสะท้อนแ<mark>สงมี</mark>ความเรียบมากกว่านี้



# บทที่ 7 สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

## 7.1 สรุปงานวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงสำหรับใช้งานกับเส้นใยนำแสงแบบ โหมดเดียวที่มีขนาดของ core 9 μm และมีขนาดของ core เมื่อรวมกับ cladding เท่ากับ 125 μm อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์ จากระบบลำเลียงแสง 6a : DXL ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสง ตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตหรือแม้แต่ อุปกรณ์ในระบบกลไฟฟ้าจุลภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาลักษณะโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ในการ สร้างจนถึงกระบวนการสร้าง พร้อมทั้งทำการออกแบบ สร้างและพัฒนารูปแบบโครงสร้างอย่าง ต่อเนื่อง อุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงของงานวิจัยนี้มีโครงสร้างเป็นสารไวแสงแบบลบ SU-8 เคลือบด้วย โลหะโครเมียมและทองคำ มีตัวขับเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซี่หวีซึ่งมีจำนวนซี่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทั้งหมด 128 ซี่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระจกจุลภาคขนาดความกว้าง 22.91 μm สูง 356 μm ให้ เคลื่อนที่เข้าออกระหว่างทางเดินแสงของสายใยแก้วนำแสงสองคู่ อีกทั้งมีสปริงแบบ serpentine ทำหน้าที่ดึงโครงสร้างตัวขับเร้าให้กลับมายังจุดเริ่มต้นเมื่อไม่มีการป้อนแรงดันไฟฟ้า

ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงพบว่า กระจกจุลภาคสามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 100 µm เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวขับเร้า 190 V ทดสอบการรับส่งแสงที่ความยาวคลื่น 1310 nm วัดกำลังแสงที่แหล่งกำเนิดแสงส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงเส้นเดียวได้ 1.5 dBm เมื่อทดลองส่ง สัญญาณแสงระหว่างสายใยแก้วนำแสงสองเส้น โดยมีตัวกลางเป็นอากาศพบว่าสามารถวัดค่าการรับ แสงได้ดีที่สุด -11.17 dBm ซึ่งคิดเป็นค่าการสูญเสียทางแสงผ่านอากาศเมื่อเทียบกับการส่งผ่าน สายใยแก้วนำแสงโดยตรงได้ -12.67 dB จากนั้นทดสอบการรับส่งแสงผ่านการสวิตซ์จากกระจก จุลภาคพบว่า เมื่อกระจกจุลภาคอยู่ในสถานะสวิตซ์เปิด (switch on) สามารถวัดค่าการรับแสงที่ดี ที่สุดได้ -22.22 dBm และเมื่อกระจกจุลภาคอยู่ในสถานะสวิตซ์ปิด (switch off) สามารถวัดค่าแสงที่ รับได้ดีที่สุดได้เท่ากับ -38.42 dBm ซึ่งค่าการสูญเสียทางแสงผ่านการสวิตซ์ด้วยกระจกจุลภาค

### 7.2 ข้อเสนอแนะ

อุปกรณ์สวิตซ์เซิงแสงที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ยังเกิดปัญหาต่าง ๆ ในขณะทำการวิจัยหลายอย่าง ได้แก่ โครงสร้างของชิ้นงานเกิดการหลุดจากฐานเนื่องจากได้รับพลังงานจากการอาบรังสีมากเกินไป ทำให้ต้องปรับหาค่าพลังงานสะสมในสารไวแสงที่เกิดจากการฉายรังสีเอกซ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่ทำให้ ชิ้นฐานหลุดออกจากฐาน ปัญหาต่อมาคือปัญหาในการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ ในกระบวนการชุบ โลหะเงินด้วยไฟฟ้าของขั้นตอนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์นั้น มักจะเกิดการแทรกตัวของโลหะ ด้านล่างสารไวแสงทำให้บดบังลวดลายบริเวณฐานของชิ้นงาน หรือโลหะเกิดการก่อตัวบนแผ่น กราไฟต์อย่างไม่สม่ำเสมอ บางพื้นที่เกิดการก่อตัวขึ้นเร็วกว่าพื้นที่อื่น ๆ จนไปปกคลุมลวดลาย บางส่วนของชิ้นงาน ทำให้ลวดลายเกิดการผิดเพี้ยน ทำการแก้ไขโดยปรับหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ เหมาะสมที่โลหะจะก่อตัวขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าในการชุบโลหะสูงเกินไป เนื่องจากจะเกิดฟองขึ้นบริเวณพื้นผิวของแผ่นกราไฟต์ทำให้บริเวณนั้นไม่มีโลหะมาเกาะ

ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้คือ การบิดเบี้ยว โก่ง งอของโครงสร้าง เนื่องจากโครงสร้างของอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงในงานวิจัยนี้เป็นพอลิเมอร์ ข้อดีของพอลิเมอร์คือมี น้ำหนักเบา แต่ข้อเสียคือเปราะบางและเสียรูปได้ง่ายเมื่อได้รับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งบ่อยครั้ง ที่เกิดปัญหานี้ขึ้นระหว่างการทำวิจัย วิธีแก้ไขคือพยายามควบคุมอุณหภูมิในทุกขั้นตอนของการสร้าง โครงสร้างอุปกรณ์สวิตช์เชิงแสงให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา คือพยายามไม่ให้อุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงเร็วเกินไป เพื่อลดโอกาสที่โครงสร้างชิ้นงานจะเกิดการผิดรูป เสียหาย



ภาคผ<mark>นว</mark>ก

# โปรแกรมแบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์







% -----Find J----- $A = sum((1./(i.^5)).*tanh((pi*w.*i)/(2*t)));$  $B = (1-((192/pi^5)^*(t/w))^*A);$ //ค่าคงที่ของการบิด  $J = (1/3)^*(t^3)^*w^*B;$ % -----Find K-----//ความกว้างของสปริง La = 500e-6; Lb = 3000e-6; //ความยาวของสปริง //โมเมนต์ความเฉื่อยของสปริง  $Ix = (w^{*}(t^{3}))/12;$ //ค่าคงที่สปริง K = (48\*G\*J)/(La^2\*(((G\*J\*La)/(E\*lx))+Lb)\*n^3); % -----Find N-----//พื้นที่แผ่นตัวนำ A = A w \* A h;//จำนวนแผ่นตัวนำ  $N = (8^{K*g} \ 0^{3}) . / (27^{Eo*Er*A*(V.^2)});$ //กราฟที่ 5 figure(5) //แสดงจำนวนแผ่นตัวนำกับขนาดแรงดันไฟฟ้า plot(N,V) xlabel('Number of Finger for Moving Plate, N'); \_ //แสดงชื่อแกน //แสดงชื่อแกน ylabel('Pull-In Voltage, V (Volt)'); %------Compare comb-drive between designs with fabrication------//จำนวนขดของสปริง n = 12; //จำนวนซี่ของตัวขับเร้า N = 128: <mark>//ค่า</mark>ความยืดหยุ่นของวัสดุ E = 2e9: //ค่าอัตราส่วนของปัวซอง v = 0.22;//ค่า permittivity ของอากาศ Eo = 8.85e-12; //ค่า permittivity ของวัสดุฉนวนที่กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง Er = 1; //ความกว้างของซี่หวี wd = 50e-6; //ความสูงของซี่หวี td = 350e-6; //ระยะห่างระหว่างซี่หวี gd = 50e-6;//ความกว้างของซี่หวี wf = 43.17e-6; //ความสูงของซี่หวี tf = 356e-6; //ระยะห่างระหว่างซี่หวี gf = 62.56e-6;//ค่ามอดูลัสของการบิด  $G = E/(2^{*}(1+v));$ i = 1:2:100;





#### บรรณานุกรม

- พิทยา ดีกล้า. 2552. การพัฒนามอเตอร์จุลภาคแบบไฟฟ้าสถิต. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา ไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 169 น.
- วินัย วันบุรี. 2550. การพัฒนากระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาคโดยวิธีการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี. 96 น.
- Steiner, H., Hortschitz, W., Stifter, M., & Keplinger, F. (2014, May). Thermal actuated passive bistable MEMS switch. In Microelectronic Systems Symposium (MESS), 2014 (pp. 1-5). IEEE.
- Plander, I., & Stepanovsky, M. (2017, November). MEMS technology in optical switching. In Informatics, 2017 IEEE 14th International Scientific Conference on (pp. 299-305). IEEE.
- Chang-Hyeon Ji, Youngjoo Yee, Junghoon Choi, Seong-Hyok Kim, and Jong-Uk Bu. (2004). Electromagnetic 2x2 mems optical switch. IEEE Journal Of Selected Topics In Quantum Electronics, Vol. 10, No. 3, May/June 2004, pp. 545-550.
- Cornel Marxer and Nicolaas F. de Rooij. (1999). Micro-opto-mechanical 2x2 switch for single mode fibers based on plasma-etched silicon mirror and electrostatic actuation. Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 1, January 1999, pp. 2-6.
- Gabriel M. Rebeiz. RF mems: theory, design, and technology. A John Wiley & Sons Publication. Copyright 2003 John Wiley & Sons, Inc.
- Gregory N. Nielson and George Barbastathis. (2006). Dynamic pull-in of parallel-plate and torsional electrostatic mems actuators. Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 15, No. 4, August 2006, pp. 811-821.
- Hiroshi Toshiyoshi, Daisuke Miyauchi, and Hiroyuki Fujita. (1999). Electromagnetic torsion mirrors for self-aligned fiber-optic crossconnectors by silicon micromachining. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, VOL. 5, NO. 1, January/February 1999, pp. 10-17.
- Ho Nam Kwon and Jong-Hyun Lee. (2004). A micromachined 2x2 optical switch aligned with bevel-ended fibers for low return loss. Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 13, No. 2, April 2004, pp. 258-263.

- Koji Akimoto, Yuji Uenishi, Kazuharu Honma, S hinji Nagaoka. (1997). Evaluation of comb-drive nickel micromirror for fiber optical communication. IEEE MEMS : 66-71
- Raanan A. Miller, Yu-Chong Tai, Guoda Xu, John Bartha, and Freddie Lin. (1997).
  An Electromagnetic mems 2 x 2 fiber optic bypass switch. International Conference on Solid-State Sensors and Actuators, Chicago, June 16-19, 1997, pp. 89-92.
- Shi-Sheng Lee, Long-Sun Huang, Chang-Jin Kim, and Ming C. Wu. (1999). Free-space fiber-optic switches based on mems vertical torsion mirrors. Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 1, January 1999, pp. 7-13.
- Somlay, G., Szucs, Z., Poppe, A., and Rencz, M. (2007). Simulation of a comb drive for fracture lifetime measurements. Excerpt from the Proceedings of the COMSOL Users Conference.Bart, S.F., Mehregany,
- Toshiki Hirano, Tomotake Furuhata, Kaigham J. Gabriel, and Hiroyuki Fujita. (1992). Design, fabrication, and operation of submicron gap comb-drive microactuators. Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. I . No. 1, March 1992, pp. 52-59.
- Wenjing Ye, Subrata Mukherjee, and Noel C. MacDonald. (1998). Optimal shape design of an electrostatic comb drive in microelectromechanical systems. Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 7, No. 1, March 1998, pp. 16-26.



## ประวัติผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2531 และ MS และ PH.D. จาก Florida Institute of Technology, USA เมื่อปี 1993 และ 1998 ตามลำดับ เริ่มงานในตำแหน่งวิศวกรที่บริษัท Elcom Research เมื่อปี พ.ศ. 2531 และบริษัท การบินไทย จำกัด ในปี พ.ศ. 2532 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้เริ่มในตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปี พ.ศ. 2536

